

# 半导体芯科技

**SS SILICON CHINA**  
SEMICONDUCTOR

ISSN 2523-1294

www.siscmag.com

2024年12月 / 2025年1月

**Greene Tweed**

**Greene Tweed 引领**

**先进半导体制造精密  
密封技术潮流**

**P.12**



微信公众号

**ACT**  
INTERNATIONAL

Angel  
BUSINESS COMMUNICATIONS

**掩模版世界正在转向曲线 P.16**

**先进热控制提高晶圆制造良率 P.20**

**高效光子器件测试和组装 P.24**

**突破功率极限 P.28**

# 国际知名媒体授权 报道全球高新科技信息



免费  
索阅

服务于机器视觉设计、电子制造、激光/光电子、射频/微波、化合物半导体、半导体制造、洁净及污染控制、电磁兼容等领域的专业读者及与会者。

品牌会议



国际代理

CQ Publishing (Japan)

Chomdan (Korea)

Pan Global (Europe)

Endeavor Business Media (USA)

Horizon House (USA)

Angel Business Communications (UK)



股票代码  
688082

[www.acmrcsh.com.cn](http://www.acmrcsh.com.cn)

## 盛美半导体设备(上海)股份有限公司

盛美上海公司简介盛美半导体设备(上海)股份有限公司成立于2005年,是上海市政府科教兴市项目重点引进的集成电路装备企业。集研发、设计、制造、销售于一体,为全球客户提供高端半导体前道工艺设备和先进封装设备。主要产品有单晶圆及槽式湿法清洗设备、电镀设备、无应力抛光设备、立式炉管设备、前道涂胶显影设备、PECVD设备,以及晶圆级与面板级封装设备。

### 前道半导体工艺设备

#### 清洗系列设备

可用于芯片制造的薄膜沉积前后清洗、干法刻蚀后清洗、离子注入灰化后清洗、化学机械研磨后清洗、抛光和外延工艺后的清洗等工艺。(设备种类包括:单片SAPS和TEBO兆声波清洗、单片清洗、单片槽式组合清洗、背面清洗、边缘湿法刻蚀、刷洗、槽式清洗)。



#### 前道电镀系列设备

种类包括:前道大马士革铜互连电镀设备、TSV电镀设备、第三代化合物半导体电镀设备等。



#### 立式炉管设备

可用于逻辑电路和存储电路中前道工艺中的多晶硅,氮化硅氧化硅薄膜沉积,主要包括 LPCVD、氧化炉、扩散炉和炉管 ALD 设备。



#### 前道涂胶显影TRACK设备

支持ARF、I-LINE、KRF等光刻工艺。

### 后道先进封装工艺设备

#### 电镀设备



可用于先进封装PILLARBUMP、RDL、HD FAN-OUT和TSV中,铜、镍、锡、银、金等电镀工艺。

#### 涂胶设备



可用于先进封装的12英寸及8英寸晶圆的正负胶和薄厚胶的涂胶工艺。

### 硅材料衬底制造工艺设备

#### Post-CMP清洗设备

用于制造高质量衬底化学机械(CMP)工艺之后的清洗;6英寸和8英寸的配置适用于碳化硅(SiC)衬底制造;8英寸和12英寸配置适用于硅片制造。



#### 湿法刻蚀设备

可用于先进封装的12英寸及8英寸晶圆的湿法硅刻蚀和UBM的铜、钛镍、锡、金等金属湿法刻蚀工艺。



# 目录 CONTENTS

## 封面故事 Cover Story

- 12 用于先进半导体制造的精密密封技术：Greene Tweed 引领潮流  
Precision sealing for advanced semiconductor manufacturing:  
Greene Tweed leads the way

作为 FFKM Chemraz® 密封解决方案的全球领导者之一，Greene Tweed 公司深知，在像半导体制造这样复杂且极具挑战性的行业中，密封件必须是最优的。我们了解一下，为了确保芯片制造商在这个前所未有的增长时代拥有实现蓬勃发展所需的各项条件，Greene Tweed 是怎样提升自身竞争实力的。



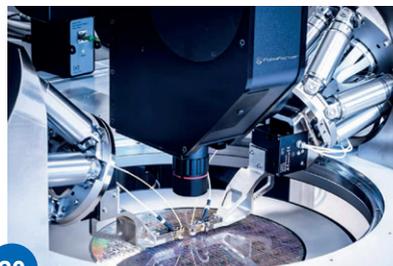
12

## 编者寄语 Editor's Note

- 4 中国市场为 IC 设计创新提供广阔空间和无限机遇

## 行业聚焦 Industry Focus

- 5 全球首条 6 英寸 Micro LED 量产线在珠海建成
- 5 ASM 推出 PE2O8 碳化硅外延机台
- 6 AIXTRON 新创新中心支持化合物半导体向 300mm 晶圆过渡
- 6 博通推出 3.5D F2F 封装技术
- 7 英飞凌推出超薄硅功率晶圆处理技术
- 7 纳米级 3D 晶体管面世
- 8 Manz 亚智科技 RDL 制程打造 CoPoS 板级封装路线
- 9 将 OLED 显示屏引入电脑和电视机
- 10 耐晶科技推出 SERENO 设备
- 11 Kioxia 公布其新兴存储器技术
- 11 国内首条玻璃基半导体特殊工艺生产线即将投产
- 27 美国对华出口限制措施再升级



20



35

### 关于雅时国际商讯 (ACT International)



雅时国际商讯 (ACT International) 成立于1998年，为高速增长的中国市场中广大高技术行业服务。ACT通过它的一系列产品—包括杂志和网上出版物、培训、会议和活动—为跨国公司及中国企业架设了拓展中国市场的桥梁。ACT的产品包括多种技术杂志和相关的网站，以及各种技术会议，服务于机器视觉设计、电子制造、激光/光电子、射频/微波、化合物半导体、半导体制造、洁净及污染控制、电磁兼容等领域的约二十多万专业读者及与会者。ACT亦是若干世界领先技术出版社及展会的销售代表。ACT总部在香港，在北京、上海、深圳和武汉设有联络处。www.actintl.com.hk

### About ACT International Media Group

ACT International, established 1998, serves a wide range of high technology sectors in the high-growth China market. Through its range of products -- including magazines and online publishing, training, conferences and events -- ACT delivers proven access to the China market for international marketing companies and local enterprises. ACT's portfolio includes multiple technical magazine titles and related websites plus a range of conferences serving more than 200,000 professional readers and audiences in fields of electronic manufacturing, machine vision system design, laser/photronics, RF/microwave, cleanroom and contamination control, compound semiconductor, semiconductor manufacturing and electromagnetic compatibility. ACT International is also the sales representative for a number of world leading technical publishers and event organizers. ACT is headquartered in Hong Kong and operates liaison offices in Beijing, Shanghai, Shenzhen and Wuhan.

### 关于《半导体芯科技》

《半导体芯科技》(原半导体科技)中国版 (SiSC) 是全球最重要和最权威的杂志Silicon Semiconductor的“姐妹”杂志，由香港雅时国际商讯出版，报道最新半导体产业新闻、深度分析和权威评论。为中国半导体专业人士，提供他们需要的商业、技术和产品信息，帮助他们做出购买决策。《半导体芯科技》内容覆盖半导体制造、先进封装、晶片生产、集成电路、MEMS、平板显示器等。杂志服务于中国半导体产业，包括IC设计、制造、封装及应用等。

### About Silicon Semiconductor China

Silicon Semiconductor China is the 'sister' title to Silicon Semiconductor - the world most respected and authoritative publication, published by ACT International in Hong Kong (former SST China), reports the latest news, in-depth analysis, and authoritative commentary on the semiconductor industry. It provides for Chinese semiconductor professionals with the business and technology & product information they need to make informed purchasing decisions. Its editorial covers semiconductor manufacturing, advanced packaging, wafer fabrication, integrated circuits, MEMS, FPDs, etc. The publication serves Chinese semiconductor industry, from IC design, manufacture, package to application, etc.

# 目录 CONTENTS

## 技术 Technology

- 16** 为什么掩模版世界正在转向曲线（一）  
Why the mask world is moving to curvilinear (1)
- 20** 先进的热控制技术可以提高晶圆制造良率  
Advanced thermal control techniques to improve wafer manufacturing yield
- 24** 高效光子器件测试和组装的主动对准引擎的新进展  
Advances in active alignment engines for efficient photonics device test and assembly
- 28** 突破功率极限  
Pushing the power envelope

## 专栏 Column

- 34** 芯粒时代即将到来：这对您有何益处？  
The Chiplet Universe Is Coming: What's in It for You?
- 35** 使用建模和仿真设计电动汽车的安全电池管理系统  
Design safe battery management systems for electric vehicles using modeling and simulation
- 37** 打造“CPU+”异构计算平台，Arm 灵活应对各类 AI 工作负载  
Arm flexibly coping with various AI workloads by 'CPU+' heterogeneous computing platform

## 40 广告索引 Ad Index

### 《半导体芯科技》编委会（排名不分先后）

- 徐冬梅 教授级高工 中国半导体行业协会副秘书长兼封测分会秘书长
- 于大全 教授 厦门云天半导体创始人
- 姚大平 博士 江苏中科智芯集成科技有限公司总经理
- 汤 晖 教授 广东工业大学、精密电子制造技术与装备国家重点实验室
- 罗仕洲 教授 磐允科技总经理
- 林挺宇 博士 广东芯华微电子科技有限公司总经理
- 杨利华 院长 两江半导体研究院
- 王文利 教授 西安电子科技大学电子可靠性（深圳）研究中心主任 雅时国际商讯顾问
- 刘功桂 教授级高工 中国电器科学研究院股份有限公司威凯技术中心主任
- 徐开凯 教授 电子科技大学、电子薄膜与集成器件国家重点实验室
- 何 进 教授 北京大学教授、深圳系统芯片设计重点实验室主任

## 化合物半导体 等离子解决方案

### RTP快速退火炉



RTP全自动双腔  
快速退火炉

RTP半自动  
快速退火炉

### PLASMA等离子去胶



ICP PLASMA去胶机

BATCH PLASMA  
筒式去胶机

### PLASMA等离子活化



微波PLASMA清洗机

在线式真空  
等离子清洗机

扫一扫获取更多解决方案



400 9600 662 / 0769 8238 5510  
www.sindin.com / www.dynechina.com

东莞市晟鼎精密仪器有限公司  
广东省东莞市虎门镇怀雅路235号

苏州晟鼎半导体设备有限公司  
苏州市吴江区兴瑞路新时亿科技产业园17栋5层南

社长 Publisher

麦协林 Adonis Mak

adonism@actintl.com.hk

荣誉顾问 Honorary advisor

刘胜院士 Academician Liu Sheng

主编 Editor in Chief

赵雪芹 Sunnie Zhao

sunniez@actintl.com.hk

出版社 Publishing House

雅时国际通讯 ACT International

香港九龙 B,13/F, Por Yen Bldg,

长沙湾青山道478号 478 Castle Peak Road,

百欣大厦 Cheung Sha Wan,

13楼B室 Kowloon, Hong Kong

Tel: (852) 2838 6298

Fax: (852) 2838 2766

北京 Beijing

Tel/Fax: 86 10 64187252

上海 Shanghai

Tel: 86 21 62511200

Fax: 86 21 52410030

深圳 Shenzhen

Tel: 86 755 25988573 /25988567

Fax: 86 755 25988567

武汉 Wuhan

Tel: 86 27 82201291

UK Office

Angel Business

Communications Ltd.

6 Bow Court,

Fletchworth Gate,

Burnsall Road, Coventry,

CV56SP, UK

Tel: +44 (0)1923 690200

Chief Operating Officer

Stephen Whitehurst

stephen.whitehurst@angelbc.com

Tel: +44 (0)2476 718970

**ACT**  
INTERNATIONAL

ISSN 2523-1294

© 2024 版权所有 翻印必究

## 中国市场为IC设计创新提供广阔空间和无限机遇

2024年12月11-12日，“上海集成电路2024年度产业发展论坛暨第三十届集成电路设计业展览会”（ICCAD-Expo 2024）在上海世博展览馆隆重举行。通过1场高峰论坛+9场分论坛+2万平方米的设计业展览会，为集成电路产业链各个环节的企业构筑了一个在技术、市场、应用、投资等领域交流合作的平台，对集成电路发展具有重大意义。

本次大会以“智慧上海，芯动世界”为主题，深入探讨当前形势下我国集成电路产业特别是IC设计业面临的困难与挑战以及发展建议，与会嘉宾围绕EDA、IP、Chiplet、RISC-V、AI、制造、封测等领域，着重探讨半导体发展趋势、先进数字芯片设计下的EDA新路径、基于Chiplet的智慧驾驶芯片平台、RISC-V IP 2.0模式、Foundry技术创新、智算时代下的技术挑战、本土EDA的机遇与挑战等热点话题。

中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授为大会作了题为《中国芯片设计业要自强不息》的主旨报告，详细介绍了2024年中国芯片设计业总体发展情况，对过去一年中国IC设计业进行了剖析、总结和展望，特别是对中国IC设计业各环节的主要数据进行了发布与解读，并对IC设计产业的发展质量进行了分析，为产业持续发展提出了相应建议。

报告显示：2024年中国IC设计企业3626家，比上年又增加了175家。预计2024年中国IC设计业销售6460.4亿元，增长11.9%。2024年各区域销售及占比如下：长江三角洲3828亿元、50.9%，珠江三角洲1662.1亿元、22.1%，京津环渤海1038.3亿元、13.8%，中西部地区985.5亿元、13.1%。上海、深圳、北京继续位于前三位。从产品领域发布来看，通信芯片和消费电子芯片的份额占全部销售的68.48%，超过三分之二。而计算机芯片的占比不到11%，与国际上25%的占比差距巨大，由此也可以看出我国芯片产品的总体水平还处在中低端。

魏教授指出：相较于2023年8%增长率，2024年中国IC设计增长11.9%，重回高速发展轨道；但相较于全球半导体19%的增长率，中国IC设计首次低于全球增速；前10大设计公司增长乏力，对行业进步贡献变小；中国IC设计人力成本已经进入世界前列，虽然目前中国IC设计业整体还是小而散的局面，但一些企业出现了大企业病，恶性竞争带来行业内耗，不讲规则，不能优胜劣汰，行业发展出现清盘倒闭现象。

魏教授强调：产品是企业安身立命的根本，技术是芯片设计公司的生存基础。中国IC设计期待不依赖先进工艺的芯片设计技术，设计企业要与制造企业合作，联手提升产品。未来企业需要通过创新突破在竞争中取胜，不仅是传统的架构创新和系统创新，特别是要关注应用场景，实现应用创新，中国巨大的市场为IC设计应用创新提供了广阔空间和无限机遇。

赵雪芹

## 全球首条6英寸Micro LED量产产线在珠海建成

京东方华灿 Micro LED 晶圆制造和封装测试基地项目投产仪式近日在珠海金湾区举行。该项目是全球首个实现规模化量产的 Micro LED 生产线，也是全球首条 6 英寸 Micro LED 生产线。

该项目自 2023 年 7 月底正式动工以来，历经项目封顶、工艺设备搬入、产品点亮等重要节点，仅用 16 个月就实现项目投产，成为全球首条 6 英寸 Micro LED 量产产线，同时也是同行业第一个实现产线自动化的 Micro LED 芯片制造工厂，在 MPD (Micro LED 像素组件) 封装、巨量转移、色彩转换等方面具有显著技术优势。

此次正式投产的 Micro LED 晶圆制造和封装测试基地项目是京东方华灿布局新型显示技术的重要平台。其生产产品为 Micro LED 晶圆和像素器件，主要面向超大和超小尺寸的高清显示场景，用于大尺寸商用显示、AR/VR 头戴式显示设备和可穿戴设备等应用领域，全部达产后

将实现年产 Micro LED 晶圆 2.4 万片组 (6 寸片)、Micro LED 像素器件 45,000kk 颗的生产能力。

新型显示产业作为新一代信息技术核心产业，是加快发展新质生产力的重要领域，也是珠海重点发展的战略性新兴产业之一。Micro LED 作为重要的新型显示技术，具有高亮度、高对比度、高响应速度、低功耗、高可靠性、长寿命等技术特性，相比于 LCD、OLED、Mini LED 等技术路线，在图像解析度、系统续航能力、扭曲弯折设计、环境适应性、产业链兼容性等多个方面具有显著优势。

该项目的建成投产填补了广东乃至全国新型显示产业空白，将有效助力珠海抢占“终极显示技术”发展先机，打造具有全球竞争力的新型显示产业集群，进一步带动更多上下游企业落户珠海，为粤港澳大湾区打造超高清显示 Micro LED 产业基地注入强劲动能。

## ASM推出PE2O8碳化硅外延机台

ASM 推出适用于碳化硅外延的新型双腔机台 PE2O8。该产品专为满足先进碳化硅功率器件的制造需求而设计，是一款拥有低缺陷率和高工艺一致性的标杆性外延机台，可广泛应用于各类碳化硅器件的制造，在实现增加产量的同时，降低拥有成本。

随着电气化趋势的不断演进，越来越多的功率器件制造商选择将碳化硅应用于需求与日俱增的大功率器件中，这其中就包括电动汽车、绿色能源和先进数据中心等产业。同时，越来越多的产业也对于碳化硅器件的应用提出了低成本的要求，促使碳化硅晶圆从 6 英寸到 8 英寸的升级进一步加快。此外，受益于当下更为先进的碳化硅外延技术，

碳化硅设备制造商设计更大功率器件的能力也得到了增强。

得益于其独特的双腔设计，PE2O8 机台可以通过尤为精确的控制方式沉积碳化硅，实现了更高产量和吞吐量。其高度紧凑的独立双腔设计也有效保障了高生产率和低运行成本。此外，PE2O8 机台还采用了更为简便的预防性维护措施，有助于延长设备正常运行时间，减少计划外停机时间。目前，ASM 已向全球多家行业领先的碳化硅功率器件制造商交付了 PE2O8 机台。

ASM 公司副总裁兼等离子体和外延业务部门负责人 Steven Reiter 表示：碳化硅功率产品正经历着一场关键的技术转折期。客户逐渐从 6 英寸晶圆向 8 英寸过渡，这一过程势必会对良率、外延工艺，以及产品缺陷控制等方面提出更高的要求。凭借新颖的腔室设计，ASM 已成为了碳化硅领域工艺一致性的行业标杆。随着此次 PE2O8 机台推出，我们的相关产品组合也进一步升级，能够以更低的拥有成本改善工艺控制，客户创造更高的价值。

先晶半导体 (ASM) 成立于 1968 年，通过半个多世纪的发展，ASM 已在原子层沉积、外延、化学气相沉积、Si 和 SiC 外延等领域取得卓越成就。



## AIXTRON新创新中心支持化合物半导体向300mm晶圆过渡

2024年12月13日，AIXTRON在位于德国黑措根拉特的公司总部举行新创新中心开幕仪式，AIXTRON展示了拥有1000平方米洁净室空间的新研发综合体，它为化合物半导体行业向300mm晶圆尺寸的过渡奠定了基础。

“随着创新中心新的具有300mm晶圆能力洁净室的建成，我们将进一步扩大我们在技术市场的领导地位，”AIXTRON公司总裁兼首席执行官Felix Grawert博士说，“我们已经拥有了第一套300mm氮化镓(GaN)原型系统，这些系统也已集成到一些客户的试产线中。几十年来，我们一直在研究技术解决方案，即使市场尚未具体定义其要求。这使我们能够在早期阶段帮助客户进行产品开发，并在需求首次出现那一刻提供为市场做好准备的创新技术。”

AIXTRON投资约1亿欧元建造了这座最先进的综合体。这座高科技大楼专为化合物半导体技术的下一个重要步骤而设计：GaN和其他化合物半导体应用向300mm晶圆尺寸的重要过渡。AIXTRON是GaN材料系统的技术领导者，由于出色的材料特性，GaN被用于越来越多的

电力电子应用。GaN器件提高了消费电子产品中充电器的效率，在可再生能源领域实现了高效的功率转换，并帮助服务器和数据中心节能电源。GaN器件也有助于人工智能在各领域的应用，因为这些应用需要大量能源。

为了满足增长的能源需求，AIXTRON正在推动300mm沉积技术的发展。与目前使用的200mm晶圆相比，更大的晶圆尺寸为客户提供了2.25倍的晶圆面积提升，300mm晶圆将进一步助力能源效率的提升。此外，客户可以首次在化合物半导体领域使用他们的300mm晶圆厂和加工设备。这将使GaN半导体器件生产不仅更具成本效益，而且还为未来的技术性能提升提供了机会。

“凭借300mm晶圆技术，我们首次将化合物半导体带入半导体制造的主流。创新中心是我们战略的重要组成部分，为下一代技术提供空间和能力。化合物半导体迈向300mm是一个里程碑，它将在未来几年为该行业带来众多增长选择。”AIXTRON先进技术副总裁Michael Heuken教授说。

## 博通推出3.5D F2F封装技术

博通公司宣布推出其3.5D eXtreme Dimension系统级(XDSiP)封装平台技术。这是业界首个3.5D F2F封装技术，在单一封装中集成超过6000mm<sup>2</sup>的硅芯片和多达12个HBM内存堆栈，以满足AI芯片的高效率、低功耗的计算需求。

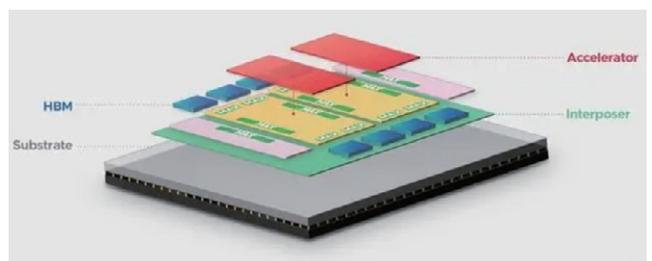
据介绍，博通的3.5D XDSiP平台在互联密度和功率效率方面较F2B方法实现了显著提升。这种创新的F2F堆叠方式直接连接顶层金属层，从而实现了密集可靠的连接，并最小化电气干扰，具有极佳的机械强度。博通的3.5D平台包括用于高效实现3D芯片堆叠的电源、时钟和信号互联的IP和专有设计流程。

### Broadcom 3.5D XDSiP的关键优势

**增强的互联密度：**在堆叠的芯片之间实现了比F2B技术高7倍的信号密度。

**更高的功率效率：**通过使用3D HCB而不是平面的芯片间PHY，将芯片间接口的功耗降低了10倍。

**降低延迟：**在3D堆叠中，最小化了计算、内存和



I/O 组件之间的延迟。

**紧凑的封装尺寸：**使互连器和封装尺寸更小，从而节省成本并改善封装翘曲。

博通领先的F2F 3.5D XPU集成了四个计算芯片、一个I/O芯片和六个HBM模块，利用台积电先进的工艺节点和2.5D CoWoS<sup>®</sup>封装技术。博通基于行业标准工具的专有设计流程和自动化方法学确保了芯片的首次成功，尽管其极为复杂。3.5D XDSiP已在关键IP块（包括高速SerDes、HBM内存接口和芯片间互连）上展示了完整的功能和出色的性能。这一成就凸显了博通在设计和测试复杂3.5D集成电路方面的专业技能。

## 英飞凌推出超薄硅功率晶圆处理技术

英飞凌宣布在处理和加工史上最薄的硅功率晶圆方面取得了突破性进展。这种晶圆直径为 300mm，厚度为 20 $\mu\text{m}$ ，是目前最先进的 40-60  $\mu\text{m}$  晶圆厚度的一半，仅有头发丝的四分之一。继宣布推出全球首款 300mm 氮化镓 (GaN) 功率半导体晶圆和在马来西亚居林建成全球最大的 200mm 碳化硅 (SiC) 功率半导体晶圆厂之后，英飞凌再次在半导体制造技术领域取得新的里程碑。

由于将芯片固定在晶圆上的金属叠层厚度大于 20 $\mu\text{m}$ ，因此为了克服将晶圆厚度降低至 20 $\mu\text{m}$  的技术障碍，英飞凌的工程师们必须建立一种创新而独特的晶圆研磨方法。这极大地影响了薄晶圆背面的处理和加工。此外，与技术相关的挑战，如晶圆翘曲度和晶圆分离，对确保晶圆稳定性和一流稳健性的后端装配工艺也有重大影响。20  $\mu\text{m}$  薄晶圆工艺以英飞凌现有的制造技术为基础，确保新技术能够无缝集成到现有的大批量 Si 生产线中，而不会产生额外的制造复杂性，从而保证尽可能高的产量和供应安全性。

这项创新将有助于大幅提高功率转换解决方案的效率、功率密度和可靠性，适用于 AI 数据中心，以及消费、电机控制和计算应用。与基于传统硅晶圆的解决方案相比，晶圆厚度减半可将基板电阻降低 50%，从而使功率系统中的功率损耗减少 15% 以上。对于高端 AI 服务器应用来说，电流增大会推动能源需求上升，因此，将电压从 230V 降低到 1.8V 以下的处理器电压，对于功率转换来说尤为重



要。超薄晶圆技术大大促进了基于垂直沟槽 MOSFET 技术的垂直功率传输设计。这种设计实现了与 AI 芯片处理器的高度紧密连接，在减少功率损耗的同时，提高了整体效率。

英飞凌是首家掌握 20 $\mu\text{m}$  超薄功率半导体晶圆处理和加工技术的公司。该技术已被应用于英飞凌的集成智能功率级 (直流 - 直流转换器) 中，且已交付给首批客户。同时，该技术还拥有与 20 $\mu\text{m}$  晶圆技术相关的强大专利组合，体现了英飞凌在半导体制造领域的领先创新优势。随着目前超薄晶圆技术的发展，英飞凌预测在未来三到四年内，现有的传统晶圆技术将被用于低压功率转换器的替代技术所取代。英飞凌目前拥有全面的产品和技术组合，覆盖了基于 Si、SiC 和 GaN 的器件，这些器件是推动低碳化和数字化的关键因素。

## 纳米级 3D 晶体管面世

美国麻省理工学院团队利用由铋化镓和砷化铟组成的超薄半导体材料，成功研制出一种全新的纳米级 3D 晶体管。这是迄今已知最小的 3D 晶体管，其性能和功能可比肩甚至超越现有硅基晶体管，还能在远低于传统晶体管的电压下高效运行，将为高性能节能电子产品的研制开辟新途径。相关论文发表于《自然·电子学》杂志。

该团队还将量子隧穿原理引入新型晶体管架构内。在量子隧穿现象中，电子可以穿过而非翻越能量势垒，这使得晶体管更容易被打开或关闭。为进一步降低新型晶体管“体型”，他们创建出直径仅为 6 纳米的垂直纳米

线异质结构。测试结果显示，新型晶体管可以更快更高效地切换状态。与类似的隧穿晶体管相比，其性能更是提高了 20 倍。

这款新型晶体管充分利用了量子力学特性，在几平方纳米内同时实现了低电压操作以及高性能表现。由于该晶体管尺寸极小，因此可将更多该晶体管封装在计算机芯片上，这将为研制出更高效、节能且功能强大的电子产品奠定坚实基础。目前，团队正致力于改进制造工艺，以确保整个芯片上晶体管性能的一致性。同时，他们还积极探索其他 3D 晶体管设计，如垂直鳍形结构等。

## Manz亚智科技RDL制程打造CoPoS板级封装路线

高科技设备制造商 Manz 集团领衔全球半导体先进封装趋势，凭借在 RDL 领域的优势布局，针对 RDL 增层工艺搭配有机材料和玻璃基板的应用，成功向多家国际大厂交付了 300mm、510mm、600mm 及 700mm 等不同尺寸的板级封装 RDL 量产线，涵盖洗净、显影、蚀刻、剥膜、电镀及自动化设备。同时，为跨领域客户快速集成工艺技术和设备生产，积极助力以板级封装为基础的未来玻璃基板应用于人工智能芯片，让这一愿景变成现实。

### 大芯片和异构集成

市场调研显示，先进封装市场预计在 2029 年将达到 695 亿美元，从 2023 年至 2029 年的 CAGR 为 11%，从 2023 年到 2029 年，2.5D/3D（含 CoWoS）的 CAGR 为 15%。这些增长由 AI、HPC、汽车和 AI PC 所驱动。行业领导者正越来越多地采用大芯片和异构集成策略，使用先进封装来补充前端扩展。它已成为制造厂、OSAT、IDM 和芯片设计关注的焦点。



Manz RDL 多项制程设备，应用于 FOPLP 以及 TGV 生产制程流程，助攻面板级封装量产进程。

半导体行业未来发展的驱动力是降低芯片生产成本，而板级封装 (FOPLP) 突破硅片面积的限制，在芯片尺寸变大的趋势下，应用方型基板以增加产能，无疑是实现降本增效的关键解决方案之一。此外，随着大算力需求的不断增长，业界一致认为玻璃基板将帮助芯片行业达到新的高度！

Manz 亚智科技 RDL 生产设备解决方案，能够在封装中重新分配信号路径，确保不同封装层之间的精确互连，率先助力板级封装量产落地及玻璃基板开发进程。

### CoWoS 产能吃紧，CoPoS 力当先锋

在短期内，AI 芯片催生的强劲需求超出了目前市场供量，业界正在探索更先进的封装形式与技术，从晶圆级

封装转型板级封装，以实现更好的面积利用率进而提升产能。作为板级 RDL 方案产业化的领导者之一，Manz 亚智科技认为，在当前 CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) 产能欠缺下，CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) 技术概念是驱动先进封装进阶的趋势。

CoPoS 是 CoWoS 的面板化解决方案，作为 2.5D 封装的另外一种选择，其硅中介层替换成有机材料中介层、BT 基板替换成玻璃基板，在各种互连架构中实现的再分配层，包括 RDL interposer (CoWoS-R/ CoWoS-L) 和玻璃芯基板上的 RDL (玻璃版的 FC-BGA) ——这也是当前业界形成的共识，以应对下一代更高密度的 AI 芯片。

扇出板级封装 (FOPLP)，作为扇出晶圆级封装的延伸，将多个芯片、无源组件和互连集成在一个封装内，并以重新布线层 (RDL) 工艺，将芯片重新分布在具有面积利用率优势的方形基板上进行互连，是具备产能优势的先进封装技术。FOPLP 与传统封装方法相比，提供了更大的成本效益。

随着中介层 / 有机基板将切换成玻璃，Manz 亚智科技也将 RDL 工艺实现于 510mm × 515mm 的玻璃基板，实现高带宽、高密度的 D2D 互连。这一特性在 AI 计算中尤为关键，能够有效满足数据传输与处理的迫切需求，CoPoS 概念正在逐渐地实现中。

### Manz亚智科技的RDL制程生产设备支持玻璃基板生产

Manz 亚智科技在 RDL 制程经验的基础上进行了前瞻性的技术研发，投入更多研发力量，转向以玻璃基板为基础的架构，聚焦于高密度玻璃基板与多样化化学品等制程材料的合作开发与制程设备整合设计，强调针对不同类型、不同厚度的玻璃达成内接导线金属化制程与 TGV 玻璃通孔制程技术；以不同温度控制、流态行为控制及化学药液，有效控制玻璃通孔内形状配置及深宽比，满足高纵深比的直通孔、高真圆度等制程工艺需求，以此使芯片具备更高频宽、更大密度和更强散热能力。

### Manz亚智科技支持本土定制化解决方案

近年来，中国先进封装产业受到重点支持，各地大力推进晶圆级封装、系统级封装、板级扇出封装和异质集成封装等关键技术的发展。

随着中国半导体的崛起，先进封装成为本土最具国际竞争力和先导性的产业之一。板级封装成本优势明显，与晶圆级封装实现互补，是先进封装助力下一代 AI 芯片的前锋。头部先进封装厂凭借先发优势深度布局了 2.5D 及 FOPLP 产线进入大规模建设和量产阶段，头部光电显示面板厂正在转型玻璃基板的研发试产。

Manz 亚智科技凭借本土技术和经验提供定制化解决方案，推动先进封装制程的灵活性与创新性。Manz 单板型 PLP RDL 技术已通过 L/S 15 $\mu$ m/15 $\mu$ m 的验证，并处于量产阶段。输送机类型（直列式）PLP RDL 技术已通过 L/S 5 $\mu$ m/5 $\mu$ m 的验证，也适用于小批量生产。CoPoS 技术中针对 RDL 增厚工艺搭配有机材料和玻璃基板的应用生态系统正在建设中。

面对 AI 趋势下 CoWoS 技术带来的新芯片产能不足挑战，CoWoS 面板化的 CoPoS 技术愈发受到业内关注。Manz 亚智科技板级 RDL 解决方案适用于 FOPLP、玻璃基板 TGV、异质芯片整合等多种封装和基板结构，具备卓越灵活性。

Manz 亚智科技总经理林峻生先生表示：“为了提供客户全方位及多元的 RDL 生产制程设备解决方案，迎接 AI 芯片面板级封装的快速成长商机，我们积极整合供应链伙伴，在制程、设备、材料使用上积极布局，并在我们厂内建置试验线，为客户在量产前进行验证。面板级封装将是下一代封装的新势头，Manz 从 300mm 到 700mm 的 RDL 生产制造设备拥有丰富的经验，从我们技术核心延伸实施到不同封装和基板结构，确保了客户在先进封装制程上的灵活性。”

## 将 OLED 显示屏引入电脑和电视机

应用材料公司推出 MAX OLED 解决方案，这是一项拥有专利的 OLED 像素结构和突破性显示屏制造技术，旨在将高端智能手机上前沿的 OLED 显示屏应用于平板电脑、个人电脑乃至电视机。

OLED 是全球主要智能手机制造商的首选显示技术，因为它能实现出众的显示质量、轻巧灵活的机身外形以及经久的产品品质。然而，迄今为止，事实证明将 OLED 显示屏生产规模扩大到用于制造平板电脑、个人电脑和电视机的更大玻璃面板上颇具挑战性。

MAX OLED 解决方案让扩增 OLED 制造尺寸变得简单易行，即从第 6 代玻璃基板（2.78 平方米）轻松扩增到第 8 代玻璃基板（5.5 平方米），后者的尺寸大出前者两倍左右，甚至可扩增到更大尺寸玻璃基板。此外，MAX OLED 还采用了全新的 OLED 材料沉积方式，能够提

高像素亮度和分辨率、降低显示屏能耗，并延长显示屏寿命。

MAX OLED 解决方案引起了客户的浓厚兴趣，并有多家主要显示屏制造商一再下单订购。不仅如此，应用材料公司还为全球领先的 OLED 和 QD-OLED 面板制造商之一——三星显示提供了 MAX OLED 解决方案。该公司将引进一套 Alpha 系统来评估这项新技术。

这套集成系统整合了能大规模量产优质 OLED 显示屏所需的 OLED 沉积和封装技术。OLED 显示屏制造难度大，原因在于用来发射红色、绿色和蓝色光的材料十分脆弱，一旦暴露在空气或水气中就会损坏。应用材料公司的 MAX OLED 解决方案是一项突破性技术，它运用专门设计的无掩膜工艺单独沉积和封装每个像素。这种方法精确且快速，并能良好地保持精细 OLED 材料的纯度。

应用材料公司的专有解决方案运用选择性沉积来实现精准的像素放置精度，单位面积 OLED 材料量较早前技术可高出一倍以上。该技术最多可将 OLED 显示亮度和分辨率分别提升 3 倍和 2.5 倍，达到每平方英寸约 2000 像素。这一解决方案还能让显示屏功耗降低 30% 以上，并使显示屏寿命延长多达 5 倍。

### 全新 OLED 像素结构、制造工艺和集成材料解决方案

MAX 解决方案不只是设备而已：它首先用拥有专利



的制造工艺构建出专有像素结构，从而造就出色的 OLED 像素和显示屏。这一制造体系将多个关键制造模块整合到单一高真空系统中，以保护精细的 OLED 材料免受环境侵袭，并减少影响良率的颗粒物。MAX OLED 系统集成显示了玻璃搬运、多个 OLED 沉积步骤以及 OLED 封装。应用材料公司已经在大面积 LCD 屏幕的制造中验证了 MAX OLED 使用的多种核心技术，这些 LCD 屏幕的

面板尺寸最大达到第 10.5 代 (9.9 平方米) 规格。

MAX OLED 解决方案可以降低 OLED 显示屏制造厂的能耗，大大减少 OLED 材料的用量，而且无需使用掩膜清洁化学品，因而能够减轻显示屏制造对环境的影响。

随着 MAX OLED 解决方案的推出，应用材料公司在服务于 OLED 显示屏制造领域的潜在市场有望扩大一倍以上。

## 耐晶科技推出SERENO设备

新加坡耐晶科技推出专为湿法蚀刻与清洗应用而设计的最新多腔室设备 SERENO。

SERENO 具有卓越的性能与高度的灵活性——配备了集成计量系统，用于精确控制晶圆厚度和粗糙度；内部化学供应系统支持多种工艺化学品，并具备集成混合、配比和化学分析能力，确保在晶圆拥有广泛应用性与最佳适应性。

SERENO 占地仅 12 平方米，每小时可高效处理 200 片晶圆。该平台专为前端 (FEOL) 和后端 (BEOL) 应用设计，旨在满足半导体行业对更高性能、更高精度及更高成本效益的需求，是未来半导体制造的理想选择。



### 高性能与紧凑设计的完美结合

SERENO 在晶圆处理和工艺控制方面具备高度灵活性，支持 6 英寸、8 英寸和 12 英寸等多种晶圆尺寸。其多功能处理系统能够高效处理从低于 100 微米的超薄晶圆到厚度超过 2 毫米的键合晶圆。高性能的工艺腔室结合创新的化学品分配和扫描控制，提供了最大的工艺自由度，确保晶圆处理的卓越表现。

耐晶科技首席营销官 Christian Kleindienst 表示：“SERENO 在紧凑的空间实现了高性能的晶圆湿法蚀刻与清洗，同时也充分发挥了单片晶圆技术的灵活性，不仅满足了客户对高效单片晶圆解决方案的需求，还有效降低了企业运营成本，是替代传统批量设备的理想之选。”

#### SERENO 主要特性

- 高产能：每小时处理高达 200 片晶圆。
- 占地面积：仅 12 平方米。
- 先进的工艺控制：定制化晶圆扫描与精确液体分配。
- 集成计量：内置厚度与粗糙度计量，提供实时反馈，

确保工艺一致性与质量。

- 高性能腔室：行业领先的液体流量与排气性能，确保无交叉污染。
- 多功能化学品供应：内部储存可支持多达三种工艺化学品，配有双 90 升储罐，确保工艺连续性。
- 灵活的晶圆处理：支持 6 英寸、8 英寸和 12 英寸晶圆，包括超薄和易脆称底，并具备多晶圆尺寸的桥接工具功能。

#### SERENO 应用领域

- 表面清洗：颗粒去除、聚合物去除、残留物去除、背面 / 倒角清洗、晶圆清洗
- 薄膜与金属蚀刻：背面 / 倒角薄膜蚀刻 (氮化硅 | 二氧化硅 | 多晶硅)、金属蚀刻 (钛 | 镍 | 银 | 金 | 铝 | 钨 | 铜等)、底部金属层蚀刻 (银 | 镍 | 钛等)
- 衬底蚀刻：减薄、应力消除、表面调理、Via 显露
- 支持的衬底：硅、碳化硅、氮化镓、砷化镓、氧化铝、氧化锌

## Kioxia公布其新兴存储器技术

Kioxia 致力于半导体存储器的研发，这对于人工智能的进步和社会数字化转型至关重要。除了其最先进的 3D 闪存技术 BiCS FLASH™ 之外，Kioxia 在新兴存储器解决方案的研究方面也卓有成效。公司不断努力，以创新的存储器产品满足未来计算和存储系统的需求。

现有的计算系统利用 DRAM（一种主要的存储器，使 CPU 能够快速处理数据）以及闪存来存储海量数据。Kioxia 正引领存储级存储器 (SCM) 的研发，SCM 是一种位于半导体存储器层级结构中 DRAM 和闪存之间的存储器解决方案，旨在以比 DRAM 更大的容量和比闪存更高的速度处理数据。

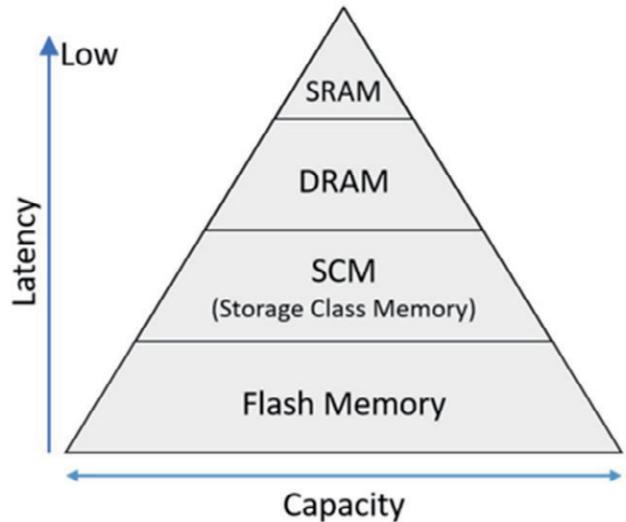
Kioxia 于 2024 年 12 月 7-11 日在美国旧金山举行的 IEDM 2024 会议上公布其新兴存储器技术，展示其面向 AI、计算和存储系统的创新应用。

### 氧化物半导体通道晶体管 DRAM (OCTRAM)

该技术由南亚科技和 Kioxia Corporation 联合开发。双方开发了一种垂直晶体管，通过改进制造工艺增强了电路集成度。同时，通过利用氧化物半导体的特性提升晶体管性能，实现了极低的电流泄漏。这有望降低各种应用的功耗，包括 AI、后 5G 通信系统以及物联网产品。

### 高容量交叉点MRAM技术

该技术由 SK 海力士和 Kioxia Corporation 联合开发。通过该技术，双方结合适用于大容量的选择器与磁性隧道结的单元技术，并应用交叉点型阵列的精细加工技术，在



存储器层级结构（图：美国商业资讯）

MRAM 最小的单元半间距 20.5 纳米规模上实现了单元读 / 写操作。随着存储单元小型化，存储器可靠性往往会下降。双方利用选择器瞬态响应的新读出方法，并降低读取电路的寄生电容，开发出一种潜在的解决方案。该技术在 AI 和大数据处理方面具有实际应用价值。

### 采用水平单元堆叠结构的下一代 3D 存储器技术

Kioxia 开发了一种新的 3D 结构来提高可靠性并防止 NAND 型单元性能下降。在传统结构中，堆叠层数增加通常会导致性能下降。与垂直排列 NAND 型单元的传统结构相比，新结构通过水平堆叠 NAND 型单元。这种结构允许以低成本实现高比特密度和高可靠性的 3D 闪存。

## 国内首条玻璃基半导体特殊工艺生产线即将投产

玻芯成（重庆）半导体科技有限公司近日举行国内首条玻璃基半导体特色工艺生产线核心设备搬入仪式，顺利搬入涪陵高新区（综保区）电子信息标准化厂房，开始安装调试设备并实现单台设备投产，全产线预计 2025 年上半年投产。

玻芯成量产线一期总投资 1 亿元，2024 年年底前完成设备安装调试，实现玻璃基半导体产品全流程生产，达产后年产值 3 亿元。

玻芯成专注于玻璃基半导体产品的研发制造，产品广

泛应用于人工智能、工业控制、汽车电子、电力能源等多个领域。

玻芯成量产线一期生产线设备，汇聚了国内外先进半导体制造设备，涵盖激光诱导设备、精密刻蚀设备、高精度图形化设备、先进电化学沉积设备等。随着国内外先进半导体制造设备的成功入驻，玻芯成全新生产线正紧锣密鼓地推进量产，旨在为全球客户带来高精尖的玻璃基特殊工艺半导体产品，为半导体行业的创新发展注入强劲动力。



作为FFKM Chemraz®密封解决方案的全球领导者，Greene Tweed深知，在像半导体制造这样复杂且极具挑战性的行业中，密封件必须是最优的。

## 用于先进半导体制造的精密密封技术： Greene Tweed 引领潮流

半导体产业有望在六年内翻一番，达到 1 万亿美元的规模，这给制造商带来了扩大规模的压力。作为全氟化橡胶（FFKM）Chemraz® 密封解决方案的全球领导者之一，Greene Tweed 公司深知，在像半导体制造这样复杂且极具挑战性的行业中，密封件必须是最优的。我们来了解一下，为了确保芯片制造商在这个前所未有的增长时代拥有实现蓬勃发展所需的各项条件，Greene Tweed是怎样提升自身竞争实力的。

**历史**学家可能会把 21 世纪 20 年代称为“新咆哮的 20 年代”（new Roaring 20s），即人工智能（AI）的十年。当世界意识到生成式人工智能前景时，人工智能的热潮便开始了。随着 2024 年有望成为多种人工智能应用的普及之年，人工智能的发展势头处于不断上升之中。麦肯锡的研究表明，这一趋势将持续下去，到 2030 年，生成式人工智能可使高达 70% 的商业活动实现自动化，为全球经济增加数万亿美元的价值。

这些人工智能应用及其永无止境的数据需求在很大程度上依赖半导体进行处理和存储。麦肯锡预计，到 2030 年，全球半导体市场规模将翻一番，达到 1 万亿美元，对于需要扩大规模以满足市场需求的制造商来说，这就增加了风险。最重要的是，人工智能的发展也在推动他们向功能更强大、尺寸更小的处理器节点迈进，以便能在单颗芯片上安装更多日益复杂的晶体管，从而实现更精细复杂的设计。

这种复杂性意味着必须采用更先进的制造工艺，并满足更为苛刻的条件。制造过程经常必须面对极高的温度、侵蚀性化学品和恶劣的等离子体环境，这对材料和设备中的部件构成了极大的风险。整个操作过程都在洁净室中进行，而在此环境中，即使是微小的灰尘颗粒或轻微的化学污染物也会造成缺陷，并损害在制芯片的性能和可靠性。

### 打造强韧供应链，避免供应中断

在令人眼花缭乱的建造新晶圆厂的竞赛中，半导体制造商不仅要探索芯片设计、材料和架构方面的进步，还需要获得一些虽不起眼、但却不可或缺的零组件的稳定供应，如 Greene Tweed 的 Chemraz® 密封件，这一点对于制造新的先进芯片至关重要。

Greene Tweed 是全氟橡胶 (FFKM) Chemraz® 密封解决方案的全球领导者，它在工厂设备、多款新产品和制造自动化技术方面的自行投资达数百万美元，因而在这一领域的增长中居领先地位。

Greene Tweed 公司首席商务官 Shawn McCloskey 指出：“多家著名的芯片制造商都依赖 Chemraz® 密封件来制造自己功能最为强大的芯片，对于其充满挑战性的制造环境而言，次优的密封件并不足以达到理想要求。我们致力于为客户提供支持，确保他们拥有所需的密封解决方案，从而满足市场对半导体持续飙升的需求。”

随着芯片制造商转向要求更为严苛的工艺，Chemraz® 密封解决方案的重要性也在不断提高。Greene Tweed 负责 Chemraz® 产品的总经理 Thyag Sadasiwan 解释了其中的原因：“我们的 Chemraz® O 型圈和密封解决方案可以防止污染，同时能够耐受侵蚀性化学品和极高的温度，故而满足现代芯片制备的关键需求。因此，这些密封

解决方案在世界上要求最苛刻的半导体制造应用中表现出色，且经久耐用。”

使 Chemraz® 密封件变得不可或缺的另一个因素是，在更先进的制造应用中，越来越多地需要超净加工。Greene Tweed 是美国首家采用洁净室制造工艺的密封解决方案公司，完全了解超净操作在半导体行业中的重要性，并确保我们的密封件能够控制可能造成污染的微粒漂移，同时增加正常运行时间并提高晶圆良率。

### 迎接挑战

通过扩大规模，以在预期的市场繁荣期为芯片制造商提供所需的解决方案，这并非易事。但是，近期整个行业的 FFKM 材料供应出现紧张，恰逢全球芯片需求激增，这让我们对如何满足急剧增长的需求，并最大限度地减轻可能出现的供应中断所造成的影响，获得了颇有价值的见解。

Greene Tweed 根据这些见解推出了六项重大举措，以确保在客户的要求随着半导体市场需求的不断增长而发展变化时，我们能够及时提供高性能的 Chemraz® 密封解决方案。

#### 1. 在韩国新建制造工厂

Greene Tweed 正在投资扩大其面向全球半导体市场的产量和生产能力。在韩国忠清北道清州市奥昌 (Ochang, Cheongju-si, Chungcheongbukdo) 新建的占地 70,000 平方英尺 (6,500 平方米) 的工厂就是一个很好的例子。这家工厂具备端到端制造工艺能力 - 从最初的原材料挤压到成品入库。我们已经开始生产样品，并将在 2024 年晚些时候过渡到商业生产。

该工厂拥有洁净室空间，可以保持对芯片制备支持组件至关重要的纯净环境，最初将主要生产 Greene Tweed 的旗舰产品 Chemraz® 系列，该产品系列以其在要求苛刻的半导体应用中所具备的卓越性能而著称。这不仅提高了全球产能，还彰显了 Greene Tweed 公司为韩国及周边地区客户提供支持的承诺，其中包括著名的半导体领导企业。这将有助于改善交货时间，与主要客户建立更强有力的共同开发战略，并加强业务连续性计划，从而打造更健康的全球供应链。

这座顶尖的工厂采用了先进的制造技术、太阳能电池板和污水回收设施，以减轻对环境的不良影响。

此外，新工厂的设计还考虑到了可扩展性，并为今后的业务增长提供了充足的用地空间，使我们能够随着市场





需求的增加扩大生产能力。我们将分阶段推出新的生产线。未来几年，我们将提高产能，增添自动化设备，以改进生产流程，缩短交货时间。下一阶段，我们将重点关注后续的扩建，包括增建一个洁净室，以及整合尖端制造技术和工艺。

这一长期战略确保我们在 2020 年代剩余的几年乃至此后更长的时间里，能够随着半导体需求的增长，对客户不断变化的需求保持敏捷的反应速度。

## 2. 专门针对恶劣条件和规模扩展而精心设计创新产品

作为全球领先的 FFKM 密封件供应商，Greene Tweed 深知 Chemraz® 密封件对于最先进的半导体制备工艺至关重要。为了满足客户不断增长的需求，Greene Tweed 推出了两款性能卓越且富有价格竞争力的新产品 - Chemraz® G38 和 G57。

Thyag Sadasiwan 表示：“我们坚定不移地关注产品性能和供应链抗冲击性，正在开发多款新型 Chemraz® 产品，以满足各种等离子体应用不断变化的需求，同时具有极强的价格竞争力和世界一流的交付周期。这些新增产品表明，我们致力于不断创新和响应市场需求，从而确保我们的客户能够获得最佳的解决方案。”

Chemraz® G57 专为满足侵蚀性干式等离子体系统的要求而定制设计，具有更强的抗电浆腐蚀性能，可以最大限度地减少污染，从而在静态和动态氧化物蚀刻晶片加

工应用中减少故障停机时间，并提高晶片加工良率。它具有出色的耐化学性，可承受高达 300°C (572° F) 的温度，是端点窗口 (endpoint windows)、窗用密封件、缝阀密封件、钟罩密封件、隔离阀密封件、腔室密封件、阀门密封件、盖子密封件、KF 接头密封件和气体入口密封件等多种应用的理想选择。

Chemraz® G38 是为高密度等离子体系统开发的，在这种系统中，密封可靠性和污染最少化是极其重要的。它具有出色的化学兼容性，能够耐受各种腐蚀性化学品。Chemraz® G38 推荐用于粘合门密封件和腔室密封件，在沉积、远程等离子体清洗、氧化、扩散、离子注入、植入退火和快速热处理等应用中具有卓越的价值。

这一创新之旅仍在继续，另一种 Chemraz® 密封解决方案将在未来 6 ~ 12 个月内推出。此外，我们现有的密封解决方案，包括 Chemraz® 和 Fusion® F07 氟橡胶，正在被客户广泛采用，用以满足世界各地正在建造的半导体制造和 subfab 设施日益增长的需求。

## 3. 新一代制造业加速增长

Greene Tweed 正投入大量资源实现制造流程的自动化，以扩大产能，并快速满足半导体客户随着自身发展而不断增长的需求。

通过利用机器人技术和数字化解决方案对核心制造流程进行补充，Greene Tweed 为生产车间员工提供了支持，

在四家工厂均衡运作的情况下，Greene Tweed大幅增加了员工人数，以稳定生产流程，并在韩国、中国台湾和美国塞尔玛的工厂增添了多台新设备，扩大了制造能力。采取这些战略举措的目的不仅是要跟上增长的步伐，还要提高生产能力，尽量减少流程中的延误，并在交货时间上明显胜人一筹。

以消除流程瓶颈，并缩短交付周期。最大的投资用于那些影响较大的工艺步骤，如压缩成型、检测和包装，以最大限度地提高效率和生产率。

对于压缩成型，操作人员目前负责在每个周期之间移动和维护模具。Greene Tweed 已开发出一种自动化解决方案，该方案使用 6 轴机器人来移动模具，这样，操作人员只需专注于价值链上的增值作业即可，并为更多的模压机提供维护保养服务。

同样，在目前的包装操作中，操作人员负责给零部件逐个装袋和贴标签，这么做既缓慢又繁琐。我们开发了一种自动化解决方案，此方案利用多个 SCARA 机械手和一台自动装袋机来提高产量，并实现装袋质量的标准化。

此外，Greene Tweed 还建立和使用了数字孪生系统 (digital twins)，以主动评估新的创新技术，以及如何以最佳方式将其引入现有的制造设施。这些技术和专门的技术资源正在彻底改变生产线，令其更具适应性，并使我们能够迅速扩大规模，以满足客户的需求，同时又不失自身的卓越。

#### 4. 有保障的资源

在半导体这样一个周期性的市场当中，扩大生产能力只是多方位策略的一个方面，目的是为市场回暖做好准备。为了支持世界级的交付周期，Greene Tweed 已从多家供应商那里获得了可靠的原材料供应，以全面满足未来两年的预期增长需求。

在四家工厂均衡运作的情况下，Greene Tweed 公司大幅增加了员工人数，以稳定生产流程，并在韩国、中国台湾和美国塞尔玛的工厂增添了多台新设备，扩大了制造

能力。采取这些战略举措的目的不仅是要跟上增长的步伐，还要提高生产能力，尽量减少流程中的延误，并在交货时间上明显胜人一筹。

#### 5. 强化供应链抗冲击能力

随着 Greene Tweed 努力确保原材料的稳定供应，该公司正积极主动地减少对单一供应商或市场的依赖。原因如下：在大流行病导致半导体需求激增的那段时间里，全行业出现了 FFKM 供应紧张的情况，这让我们认识到供应链多样化和强化其抗冲击能力的重要性。Greene Tweed 之所以在不同地区精心选择多家原材料供货源，原因就在于此。

Greene Tweed 积极主动地识别和降低从地缘政治到监管以及气候变化事件的潜在风险，藉此建立了全面的供应链弹性和业务连续性计划，并与客户共享，以确保透明度。

通过确保原材料的安全和建立供应链的弹性，Greene Tweed 可以帮助其客户减少故障停机时间，并满足极其紧凑的生产计划，为了在预期的市场繁荣期适应快速增长的需求，这些是必不可少的。这一点在半导体行业至关重要，因为在该行业中，错过产品上市窗口期会导致收入大幅缩水。

#### 6. 为工具 OEM 的新设计做好准备

主要的半导体资本设备制造商正在进行工具升级，以转向更小的处理器节点和由此产生的复杂工艺。无论是光刻技术还是蚀刻技术的最新创新，都对晶圆设备密封件提出了更高的要求，Greene Tweed 正在采取积极措施，以跟上这种增长的步伐。Greene Tweed 获得专利的 LF10 涂层使设备制造商能够满足下一代半导体节点的严格性能要求。

与此同时，我们的橡胶黏合缝阀、盖子密封件、电镀溶液密封件、真空管路溶液密封件、低温密封件 (cryogenic seals) 和许多其他密封解决方案继续得到设备制造商的广泛采用。最近，我们的 Xyfluor® 材料在要求温度低于 -40°C 的静电吸盘溶液中通过了品质认证。

### 为增长做好准备

制造尖端半导体芯片是一项极具挑战性且成本密集型的过程，它需要依赖于诸如 Chemraz® 密封解决方案等小型但不可或缺的部件，才能取得成功。

Greene Tweed 与客户和合作伙伴开展了密切的合作，随时准备满足芯片制造商对其 Chemraz® 密封解决方案不断增长的需求，从而确保他们在 2020 年代剩余的几年乃至此后更长时间里的业务可扩展性和可持续性。◆

# 为什么掩模版世界正在转向曲线（一）

如果您最近参加过光刻或光掩模技术会议，您可能已经注意到一个趋势：出现许多关于曲线掩模、曲线 OPC、曲线ILT、曲线掩模过程校正（MPC, mask process correction）和曲线掩模格式的论文和演讲。光掩模行业正在经历从曼哈顿掩模到曲线掩模的根本转变。

作者：LEO PANG, D2S公司

那么，这种转变的动机是什么呢？经过几十年的曼哈顿掩模设计，转向曲线有什么好处呢？首先，让我们看看为向曲线掩模版的转变奠定基础的一些技术背景。

一篇 ILT 论文“Fast Inverse Lithography Technology”<sup>[1]</sup>。Luminescent 及其合作伙伴已经发表了大量论文，这些论文表明，理想的全曲线 ILT 掩模图案实现了最大的工艺窗

## ILT开始转变

曲线掩模始于逆向光刻技术（ILT, inverse lithography technology）。ILT 将掩模优化视为一个逆向的问题，从所需的晶圆目标开始，并计算将产生所需晶圆目标的掩模。晶圆扫描仪具有带宽受限的光学元件，无法产生 90 度的角，因此任何 90 度的角（尤其是具有无限频率的角尖）都会被扫描仪光学元件过滤掉，因此不包括在 ILT 解决方案中。因此，ILT 掩模图案自然是曲线的。

在 2006 年 SPIE 高级光刻会议上，Dan Abrams 和我发表了来自 Luminescent 公司的第



图2：VSB掩模版写入器的写入时间与创建掩模版形状所需的拍摄次数成正比。多束掩模写入器与形状无关，无论掩模形状如何，都具有恒定的写入时间<sup>[1]</sup>。来源：NuFlare。

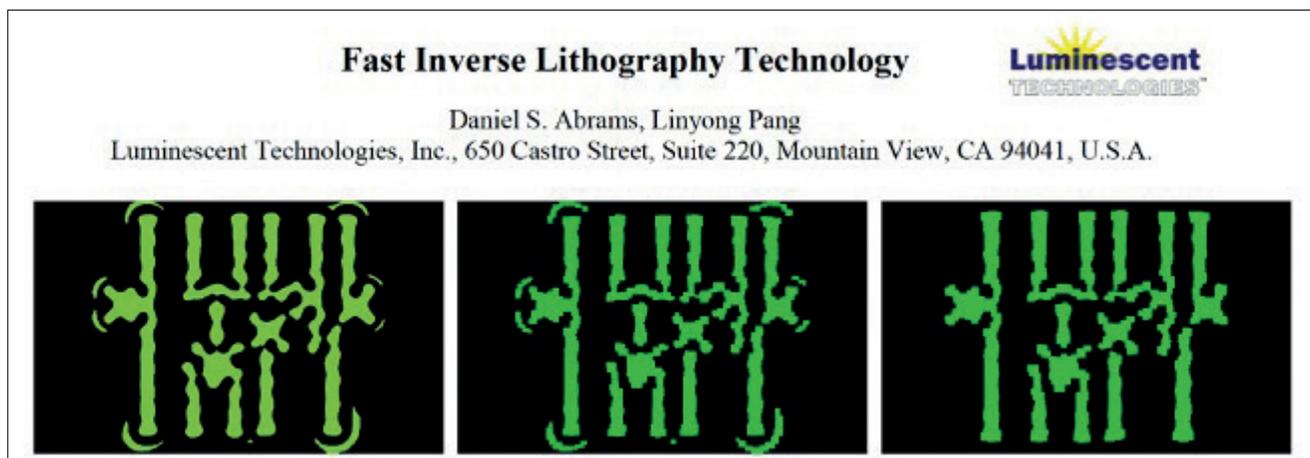


图1：由第一个ILT解决方案创建的掩模图案（左）。相同模式的“曼哈顿化”版本（中），没有SRAF的曼哈顿化ILT掩模模式（右）<sup>[1]</sup>。来源：Luminescent/Synopsys

口<sup>[2-9]</sup>。

图1在左侧显示了第一个ILT解决方案创建的掩模图案。中间是适用于可变形光束(VSB, variable shaped beam)掩模写入器的“曼哈顿化”版本,该版本只能写入直线形状。图1的右侧是没有亚分辨率辅助功能(SRAF, sub-resolution assistant feature)的曼哈顿化ILT掩模图案。

编写曲线掩模版形状或其“曼哈顿化”版本呈现出非常真实的障碍,因为表示曲线形状所需的拍摄次数高得令人望而却步。由于VSB掩模写入时间与拍摄次数成正比,因此使用VSB掩模写入器写入曲线掩模是不切实际的。

### 多束掩模版写入器、GPU计算改变了曲线掩模版的游戏规则

多束掩模写入器的出现消除了采用曲线掩模的掩模写入时间障碍。多束掩模写入器具有数十万束光束的阵列,每个光束都可以打开、关闭或以部分剂量打开。

由于写入时间仅与面积成正比,因此多束掩模写入器可以写入曲线掩模,而不会对写入时间造成任何影响,如图2所示。

ILT最初在生产中的使用主要是在有限的“热点”区域。原因是存在另一个障碍:计算全芯片ILT解决方案的难度。一个困难是运行时间,但可以使用GPU加速计算来处理运行时间。将芯片分区馈送到GPU加速计算系统中,可以加快每个分区的处理速度。但是,当分区重新拼接在一起时,会沿分区边界处产生错误。这些拼接错误和解决这些错误所需的重新计算仍然是令人心烦意乱的问题(图3)。

为了避免解决这些拼接错误所需的耗时的递归校正过程,2019年,D2S公司提出了<sup>[12]</sup>一种新的硬件/软件协同设计的解决方案,该解决方案

能够一次处理整个芯片:一个计算平台,其表现为单个巨大的GPU/CPU对,可以无缝优化全芯片数据,无需分区(图4)。

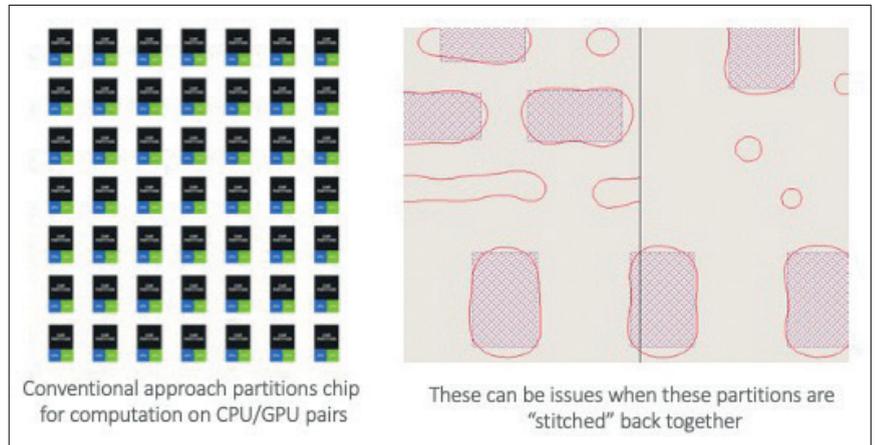


图3: 传统的全芯片方法对芯片进行分区,以便在CPU/GPU对上进行计算。当分区重新拼接在一起时,会出现问题<sup>[12]</sup>。来源: D2S

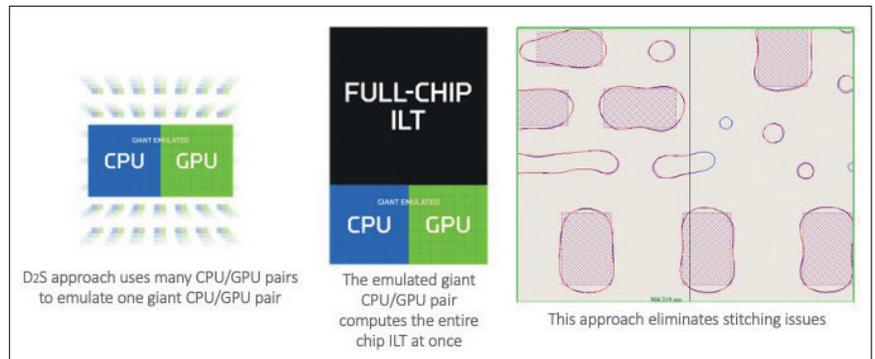


图4: 一种创新的方法模拟一个巨大的CPU/GPU对,该CPU/GPU对可以一次计算整个芯片,从而消除了拼接问题<sup>[12]</sup>。来源: D2S

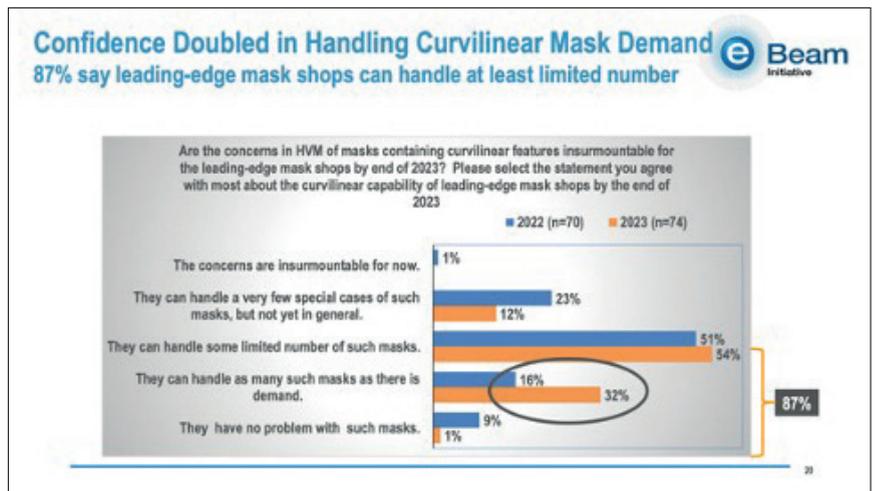


图5: 2023年eBeam Initiative杰出人士调查的结果显示,87%的受访者已准备好使用至少有限数量的曲线掩模。33%的人可以处理所需数量的掩模<sup>[14]</sup>。来源: eBeam Initiative。

如今，随着这些障碍的消除，光掩模行业对其创建曲线掩模的能力非常有信心。2023年，行业组织 eBeam Initiative 每年对行业领导者进行的一项调查中，就询问了曲线掩模的大批量生产问题。

图 5 是 2023 年 eBeam Initiative 杰出人士调查的结果，显示 87% 的受访者已准备好使用至少有限数量的曲线掩模。33% 的人表示可以处理所需数量的掩模<sup>[14]</sup>。

### 曲线掩模的动机：改进每个节点的工艺窗口

使用曲线掩模模式的优点已经得到了验证，因此，促使光掩模行业为这些变化做准备。从 2006 年的第一篇 ILT 论文开始，大量研究表明，曲线掩模可以改善所有技术节点和光刻技术的工艺窗口，从 193 干式，193 浸入，直到 EUV。2009 年，Luminescent 与三星<sup>[9]</sup>进行了一项此类研究。如图 6 所示，触点阵列的曲线掩模图案以不同的间距生成。

对于每个间距，都有一个无约束曲线的 ILT 掩模模式，然后是简化的 ILT 掩模模式，一直到非常接近 OPC 的水平。然后用剂量和焦点矩阵来光刻出晶圆，并测量 CD。当我们查看工艺窗口时，您可以看到对于每个间距，无约束曲线的掩模版图案始终提供最大的焦深。

最近在 2020 年，来自美光的 Ezequiel Russell<sup>[13]</sup>的研究表明，对于图 7 中所示的三个触点，使用全曲线 ILT 可以将焦深提高 85%。

2019 年，我和美光展示了在工艺窗口上对 OPC 的 100% 的工艺改进，该模式由上述全芯片无拼接 ILT 解决方案创建，并使用多束掩模写入

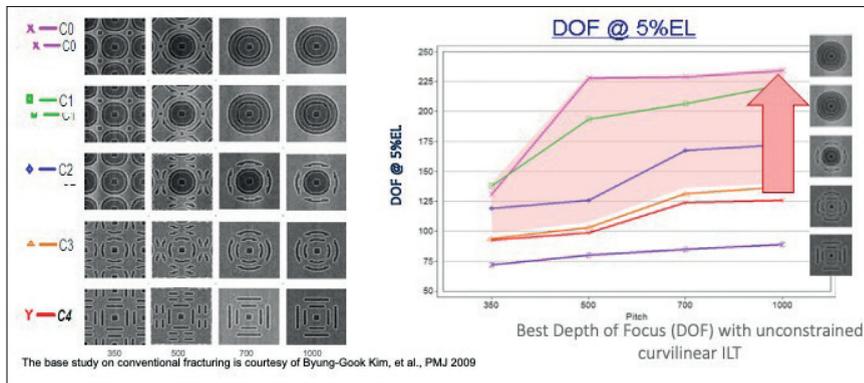


图6：使用不同级别的曲线对接触阵列的研究。最佳焦深是通过无约束曲线的ILT实现的<sup>[9]</sup>。资料来源：三星。

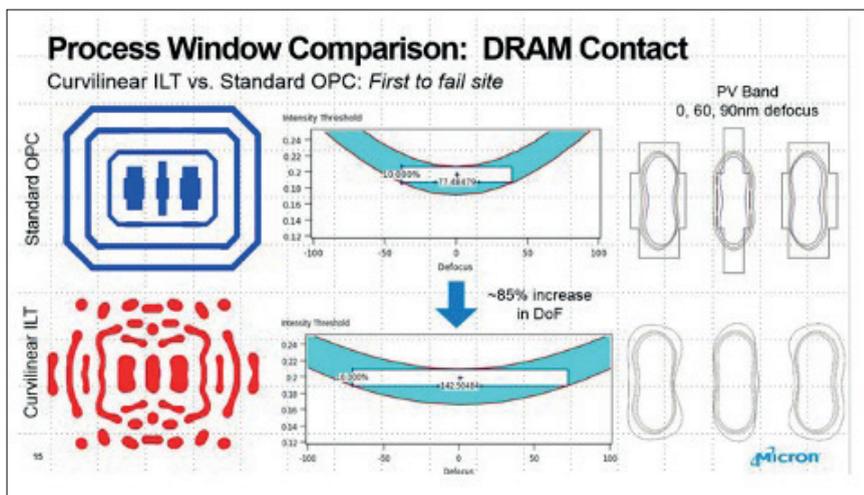


图7：与标准OPC相比，曲线ILT提供了更大的85%的焦深增加<sup>[13]</sup>。来源：美光。

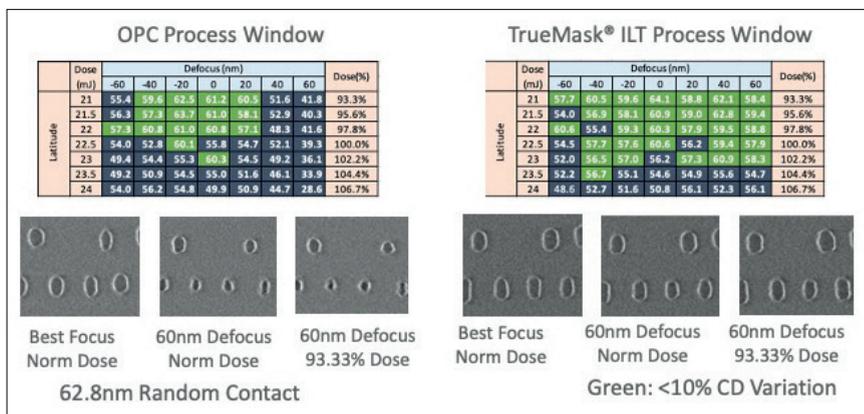


图8：与使用多束掩模写入器的标准OPC相比，曲线ILT在随机接触层上的工艺窗口上实现了100%的增加。来源：D2S和美光。

器写出。(图 8)<sup>[12]</sup>

### 曲线掩模支持更小的间距、更简单的掩模规则

使用曲线掩模图案的一些其他好

处与掩模规则有关。首先，曲线掩模版形状可以实现更小的间距。图 9 显示了一个表示一部分触点数组的简单示例。

最小的角到角掩模规则限制了您

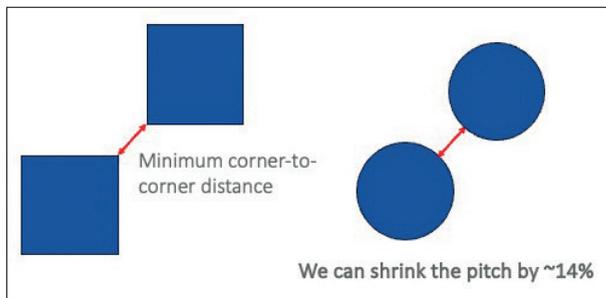


图9: 通过从直线掩模特征移动到曲线掩模特征, 间距可以收缩大约14%。

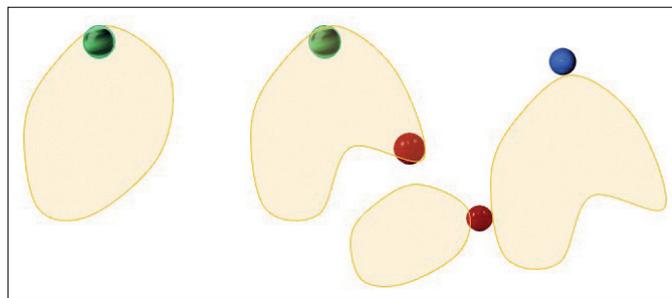


图10: 曲线掩模设计规则的简化概念: 使用最小曲率、最小CD、最小空间和最小面积<sup>[15]</sup>。来源: D2S

可以实现触点阵列的紧密程度。只需将触点的目标掩模形状从方形更改为圆形, 使用相同的掩模规则, 间距就可以减少 14%。简而言之, 曲线触点可以比曼哈特触点设计得更紧密。

曲线掩模功能也为大大简化掩模规则提供了机会, 而这只需要最小曲率、最小 CD、最小空间和最小面积<sup>[15]</sup>。图 10 使用一个直观的示例来说明这一点。

在图 10 中, 绿球的大小代表最小的 CD。如果球在给定的图案内沿着轮廓滚动, 并且没有卡住, 则意味着它满

足最小 CD 规则。如果它卡在某个地方, 如红球所示, 则表示该图案违反了最小 CD 规则。

同样, 您可以将球滚动到图案之外以确定最小间距, 如图 10 中蓝球所示。与其他模式的任何重叠 (如红球所示) 都将产生间距冲突。当然, 在实践中, 为 GPU 量身定制的快速、基于像素的算法将用来执行这一概念。◆

注: 本文基于作者在 SPIE Advanced Lithography 2024 会议上发表的一篇文章。

#### 扩展阅读/参考资料

1. Abrams, Daniel S., and Linyong Pang. "Fast inverse lithography technology." In *Optical Micro lithography XIX*, vol. 6154, p. 61541J. International Society for Optics and Photonics, 2006.
2. Hung, C. Y., et al, "Pushing the Lithography Limit: Applying Inverse Lithography Technology (ILT) at 65nm generation", Proc. SPIE 6154, (2006)
3. Lin, B., et al, "Inverse Lithography Technology at Chip Scale, 31st International Symposium of Micro lithography", Proc. of SPIE 6154, (2006)
4. Pang, L., et. al, "Laser and e-beam mask-to-silicon with inverse lithography technology (ILT)", Proc. SPIE 5992, 599221 (2005)
5. Ho, J., et. al, "Real-world impact of inverse lithography technology", Proc. SPIE 5992, 59921Z (2005)
6. Balasinski, A., et. al, "Inverse lithography technology: verification of SRAM cell pattern", Proc. SPIE 5992, 599230 (2005)
7. Hung, C., et. al, "First 65nm tape-out using inverse lithography technology (ILT)", Proc. SPIE 5992, 59921U (2005)
8. Martin, P., et. al, "Manufacturability study of masks created by inverse lithography technology (ILT)", Proc. SPIE 5992, 599235 (2005)
9. Kim, Byung-Gook, Sung Soo Suh, Byung-Sung Kim, Sang-Gyun Woo, Han-Ku Cho, Vikram Tolani, Grace Dai et al. "Trade-off between inverse lithography mask complexity and lithographic performance." In *Photomask and Next-Generation Lithography Mask Technology XVI*, vol. 7379, p. 73791M. International Society for Optics and Photonics, 2009.
10. Klein, Christof, and Elmar Platzgummer. "MBMW- 101: World's 1st high-throughput multi-beam mask writer." In *Photomask Technology 2016*, vol. 9985, p. 998505. International Society for Optics and Photonics, 2016.
11. Hiroshi Matsumoto et al., "Multi-beam mask writer MBM-1000 and its application field." In *Photomask Japan 2016: XXIII Symposium on Photomask and Next-Generation Lithography Mask Technology*, vol. 9984, p. 998405. International Society for Optics and Photonics, 2016.
12. Pang, Linyong, Ezequiel V. Russell, Bill Baggenstoss, Michael Lee, Jennifer Digaum, Ming-Chuan Yang, P. Jeffrey Ungar et al. "Study of mask and wafer co-design that utilizes a new extreme SIMD approach to computing in memory manufacturing: full-chip curvilinear ILT in a day." In *Photomask Technology 2019*, vol. 11148, p.111480U. International Society for Optics and Photonics, 2019.
13. E. Russell, "ILT and curvilinear mask designs for advanced memory designs," presented at SPIE eBeam lunch (25 February 2020). <http://www.ebeam.org>
14. 2023 eBeam Initiative Perceptions Survey Results [September 26, 2023], <http://www.ebeam.org>
15. Choi, Yohan, Aki Fujimura, and Abhishek Shendre. "Curvilinear masks: an overview." *Photomask Technology 2021* 11855 (2021): 157-172.

# 先进的热控制技术 可以提高晶圆制造良率

成功抑或失败？是否选择具有合适隔热性能的软管会起到至关重要的作用。

作者：Margaret Brennan, 世伟洛克公司应用解决方案部门首席工程主管

由于人工智能和其他技术进步需要更精细复杂的芯片，对高质量半导体晶圆的的需求随之呈指数级增长。芯片的设计制作过程从未像现在这样复杂，制造工厂、原始设备制造商和价值链的所有环节都在寻求新的方法，以最大限度地提高效率和盈利能力。

热环路的设计旨在使沉积室在整个制造过程中保持最佳的温度，从而最大限度地提高芯片良率。超低温常常用于调节腔体内的精确温度。面临的挑战是，这些温度（通常会低至 -40℃）给热环路的每个部件都带来了额外的压力。这一关键环路由冷水机（chiller）、水泵、热交换器

以及保持它们连接的所有部件组成。该系统内的任何一个部件出现故障，都会降低晶圆厂的运行效率和产量。

在半导体芯片生产领域，精度和清洁度也是相互交叉的优先事项。沉积室内部的温度必须保持在优化水平，以确保制程稳定性。同时，在精细的制备过程中，必须保持腔室没有任何潜在的污染物，以最大限度地提高芯片的生产量。

由于创建和维护理想的制备环境需要投入大量的工程和设计力量，因此，对于支持芯片生产流程的一些更“基本”部件的选择，其重要性很容易被忽视。我们来看一下

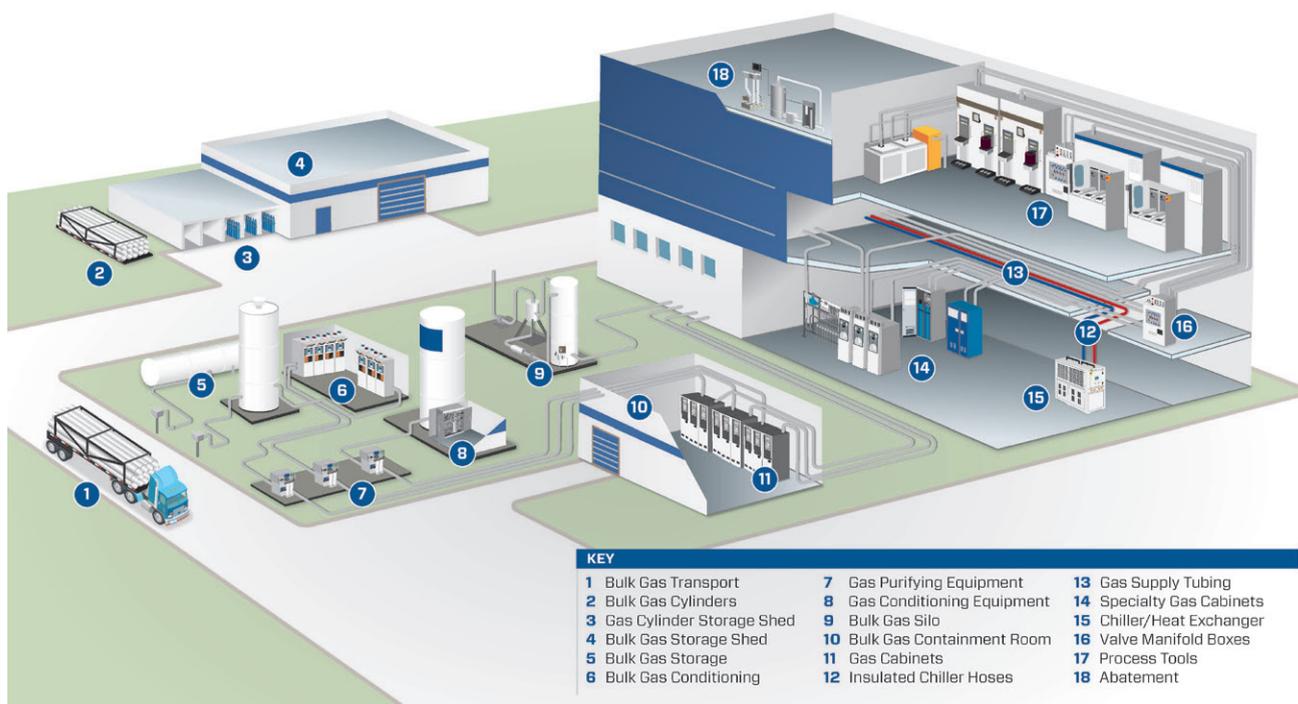


图 1：典型半导体制造作业的下部区域放置了工厂热环路的主要部件，包括有隔热保护的冷水机软管（12）、供气管道（13）、专用气柜（14）以及冷水机和热交换器（15）。

在整个制造设施中大量使用的工业软管。在半导体制造过程中，软管起着重要的作用，因为它们通常用于帮助冷水机调节生产过程所需要的环境。

正确使用软管和其他系统部件意味着，必需注意会对部件在热环路中的工作状况产生影响的三个关键方面，包括：

- 选择正确的部件
- 找到正确的隔热平衡
- 采用合适的安装和性能测试

在为半导体晶圆厂构建热环路之前，了解最佳温度控制的重要性是很关键的。如果供应商能在这个关键方面为工程师提供指导，并支持热环路结构的设计和实施，将有助于制造商优化热管理，并实现高品质芯片产量的最大化。

### 如何保持流体温度的稳定

要生产出最高质量的半导体芯片，将沉积室中的温度保持在精确的水平是不可避免的。为了调节温度，强大的冷水机将冷却剂泵入和泵出机器。必须对输送冷却剂的软管进行适当的隔热保护处理，以确保在整个制造过程中流体温度保持稳定。

例如，倘若在确定冷却温度和所需隔热材料的用量时没有考虑到流体穿过系统时产生的自然温升，就会导致腔体内的温度波动超出容限范围。这些温度波动有可能导致晶圆缺陷，因而会造成良率下降。

半导体制造商使用含乙二醇的水来防止结冰，因为乙二醇能够耐受零下 40℃ 的低温。保持超低温需要耗费大量的能源，因此使用有隔热保护的工业软管可以帮助制造商更有效地控制温度。半导体制造商极为重视将温度控制在精确的水平，目的在于生产出高质量的芯片，并降低能源成本。

### 选择正确的部件

半导体制造过程中的温度管理至关重要，因此系统设计人员必须指定正确的部件，以构建能够承受严酷工作条件的热环路。每个部件（软管、阀门、配件、过滤器，等等）都必须满足最低要求，包括应对现代的压力和流速以及极端温度（图 1）。



图 2：冷水机软管应具有合适的隔热保护能力，以帮助保持所需的温度并防止冷凝。

冷水机软管是一个特别重要的例子，因为需要对其进行隔热（图 2）。使用有隔热保护的软管可以提高冷水机的效率，将温度变化保持在最低水平，减少热量传递，并防止发生冷凝。选择具有这些特性的部件有助于提高晶圆厂的运行效率，并减少总的故障停机时间。

虽然冷凝对大多数工业应用来说是一种威胁，但是在晶圆厂里，它会导致工厂停产。除了滴水可能会损坏关键设备外，不明泄漏或污水坑总是被认为是有毒性的，这就需要进行人员撤离和疏散，直到查明介质并确定其安全为止。这种不必要的停机时间和资源分配会妨碍工厂的芯片生产，因此，配备具有合适隔热保护能力的软管至关重要（图 3）。

### 找到正确的隔热平衡

实现合适热性能的解决方案比简单地给部件添加隔热材料更为复杂。软管的长度越长，所需的隔热材料就越多，成本也就会越高。因此，安装最优用量的隔热材料可以提高系统的效率，并尽量减少不必要的成本支出。

我们对一家晶圆厂的热环路系统进行了研究，以证明具有合适隔热性能的软管可以提高效率。该工具需要  $-30^{\circ}\text{C}$  的冷冻水才能在加工过程中实现所需的温度。为此，上游的冷水机必须提供低于  $-30^{\circ}\text{C}$  的低温，以便介质进入工具时的温度达到  $-30^{\circ}\text{C}$ 。在这种情况下，工具距离冷水机 40 英尺。

如果使用不具备隔热性能的软管将介质输送过这段距离，那么冷水机需要提供的温度要比使用隔热软管时低得多，因为介质在到达工具的过程中会出现冷量损失（即热量增加）。

这会使冷水机过度工作，导致能源成本过高、维护频率增加，还有可能缩短设备的使用寿命。使用具有隔热性能的软管时，冷水机可以提供接近  $-30^{\circ}\text{C}$  的温度，因为它不需要过度补偿在介质输送到工具的过程中损失的冷量。在本例子中，每降低  $1^{\circ}\text{C}$  所耗费的成本约为每小时 27 美分。例如，节省  $44^{\circ}\text{C}$  的冷却需求，每小时可节约 11.80 美元的冷却成本。虽然具有隔热保护能力的软管成本较高，但是从它们产生的节能效果而言，这种成本的升高是物有所值的。

### 正确的安装技术和性能测试

一旦设计人员和工程师选择了合适的部件来保持有效的热管理，构建高性能系统的下一步就是安装和部署这些部件。必须严格遵守这些规程，以确保每个系统的安装都是一致、可重复、清洁和防潮的。

在晶圆厂里启动某个系统的安装操作之前，先回顾一下相关的基本知识。与大多数其他工业流体系统一样，密封性能是极其重要的。要实现无泄漏系统，技术人员必须了解管接头和阀门的安装。如果对流程中这些重要步骤的理解有误，则会导致关键流体系统出现故障，从而影响生产设施的效率和效能。

系统故障会导致意外停机、减产、安全问题和盈利能力下降。因此，在半导体制造设施中，正确地安装密封流体系统是至关重要的。

除了正确安装以外，设计师和工程师还必须仔细考虑如何布设冷水机管线。冷水机管线相互之间应保持足够的距离，以免软管表面温度降到露点以下而导致出现冷凝，甚至结冰。

软管之间的距离越近，就越有可能将周围的空气冷却到软管中冷冻介质的温度，从而引起冷凝问题。一般来说，

### 热环路的主要组成部分

热环路由以下部分构成：

- 冷水机，用于冷却在设备中循环的流体
- 热交换器，用于实现热量传递
- 有隔热保护的软管组件及焊接件、泵和阀门，它们有助于在整个循环过程中分配温控流体
- 监测和控制系统，用于调节流速和温度
- 过滤和净化系统，用于防止污染和去除杂质

隔热性能良好的软管之间至少应相隔 12 英寸（31 厘米）。如果系统的配置无法提供这样的间隔，则可能需要在线路上增设隔热层，以保持性能的完整性。

另外，停滞的空气也会影响冷却管线的表面温度。当气流增加时，管线的表面温度会更趋向于环境温度。我们以一根穿过某封闭区域（如底层地板）排布的软管为例。在冷介质流经软管的情况下，有可能导致在外部形成冷凝水，如前所述，冷凝水或许会滴到敏感设备上。

最后，虽然有隔热保护的软管的最小弯曲半径不会改变，但是，把软管弄弯有可能影响隔热性能。为了尽量减少这些影响，一般建议采用弯曲半径较大的软弯管（图 4）。如果做不到这一点，可以考虑给软管增补隔热层。请参阅本文后面的说明“怎样选择有隔热保护的软管”。



图 3：选择具有合适隔热性能的软管对于减轻晶圆厂生产操作中的冷凝问题至关重要，且可能涉及到选择真空隔热金属软管，这种软管具有出色的隔热性能，可以安全耐受极端介质温度。

## 建立有效的伙伴关系

随着半导体制造业在世界经济中的地位日益重要，降低成本的竞争也愈演愈烈。昂贵的制造工具往往难以降低成本，而这些工具能制造出高质量的芯片，为未来的技术创新提供动力。因此，对整个工厂的整体系统进行评估，寻找其他侵入性较低的方法来降低生产成本，是很有意义的。

评估低温流体输送系统是否配备了合适的软管，就能获得意想不到的节省。确定所需隔热层的精确水平能够长期地节约资金，并帮助系统在其使用寿命内以峰值效率运行 - 但是，不能指望操作员、工程师和技术人员对热管理

## 怎样选择有隔热保护的软管

在设计和安装半导体制造冷水机应用时，最重要的考虑因素是选择专为该应用设计的具有隔热保护的软管。虽然有些制造商坚持认为他们有隔热保护的软管既可用于热流体输送，也可用于冷流体输送，但是，隔热软管的性能往往因所采用的隔热类型材料的不同而不同。

例如，与更适合高温流体应用的织物覆盖层隔热软管相比，采用柔性聚烯烃热收缩套的软管在低温应用中的性能更好。选择拥有专业知识的软管供应商，帮助确定哪种材料在某项应用中最有效，以避免出现性能问题。

另一个关键点是，无论使用哪种类型的隔热，软管都必须保持柔性。如果做不到，工程师可能就无法按最佳路径布设和安装软管。例如，软管的最小弯曲半径不应随隔热材料的变化而变化，而且弯曲能力也不应影响其隔热性能。

应选择能正确（且灵活地）保持输送流体的目标温度，而且不是过于笨重的软管，例如采用低导热性气凝胶隔热材料的软管。

最后，只有隔热材料量按需使用的隔热软管才能为应用带来真正的效率。好的软管供应商不会采用一刀切的方法，而是会提供不同的隔热分层选项，以经济高效的方式满足特定应用的温度要求。在最理想的情况下，他们会要求提供应用的参数，并使用方程式来精确地确定具体软管需要多少隔热材料。

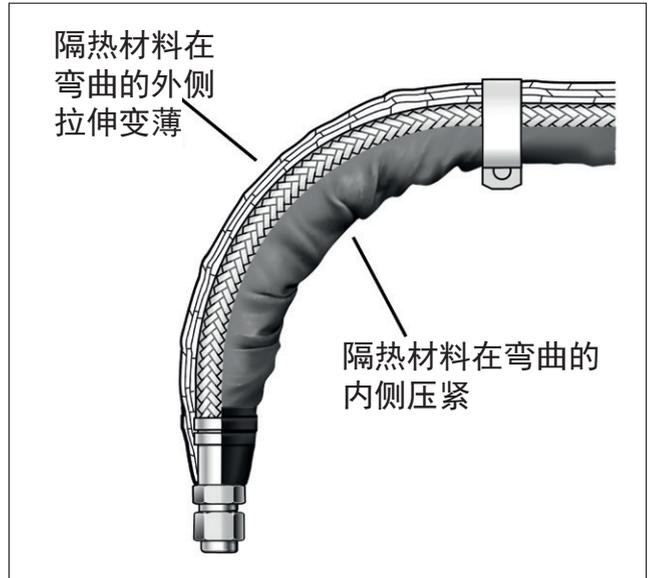


图4：注意不要过度弯曲有隔热保护的软管，以免压弯软管，影响隔热性能。

的所有相关知识都了如指掌。因此，至关重要的是找到可以就这些决策提供咨询的可信赖的供应商。

寻找一个在半导体制造方面拥有必要经验的合作伙伴，可以就哪些部件能够满足特定应用的需求获得宝贵的建议。这种指导会有助于减少安装和运行费用，从而提高盈利能力。对于有隔热保护的软管，经验丰富的合作伙伴能够帮助确定需要多少隔热材料才能保证冷水机和其他设备正常运行。市场竞争越激烈，尽可能削减不必要的开支就越重要。

与能够提供这些工具和专业知识的供应商合作，可以获得巨大的收益，包括：

- 通过防止发生冷凝减少故障停机时间
- 通过最大限度减小热量变化和实现高效介质传输提高半导体芯片良率

- 通过改善冷水机性能来提高效率并降低能源成本

在半导体晶圆制造环境中，保持热环路的最佳功能对芯片良率的稳定和最大化必不可少。与能够深入研究特定应用并为半导体晶圆生产运营提供创新解决方案的供应商合作。寻找一个具有广泛影响力的合作伙伴，他们不仅能就软管的选择提供建议，还能就其他部件给出意见。凭借通力合作，半导体晶圆厂可以随着技术的不断进步，继续推动世界向前发展并顺利运行。◆

# 高效光子器件测试和组装的主动对准引擎的新进展

光子学市场正在迅速发展，预计未来十年将有大量采用该技术的行业出现大幅增长。由于光子器件会具有数百甚至数千个单独组件和连接，制造商必须进行并行优化，因此，主动对准成为满足生产需求的最佳选择。

作者：Scott Jordan, Stefan Vorndran, Warren Harvard; PHYSIK INSTRUMENTE L.P. (PI)

半个多世纪以来，电子通信和计算领域的创新步伐不断加快，产生了越来越小、处理能力越来越强的硅微芯片。这一成就归因于集成电路（IC）晶体管密度的指数级增长，英特尔共同创始人 Gordon Moore 在 1965 年预测了这一发展，通常被称为摩尔定律。然而，在量子效应开始影响硅结构的功能之前，减小硅结构的物理特征尺寸存在固有的限制。

幸运的是，光子器件已经开始帮助了电子产品，使小型光学器件能够集成到各种应用中，从可穿戴设备中的传感器到自动驾驶汽车中的 LiDAR 和 ADAS 摄像头。光子器件有可能超越传统电子产品，将数据吞吐量和效率与小型化相结合，在远程通讯和数据通信领域引发真正的革命。为了保持这种增长，必须解决光子器件制造中仍然存在的挑战和瓶颈。实施额外的自动化解决方案，尤其是那些确保快速和精确组件对齐的解决方案，对于满足未来发展的需求至关重要。

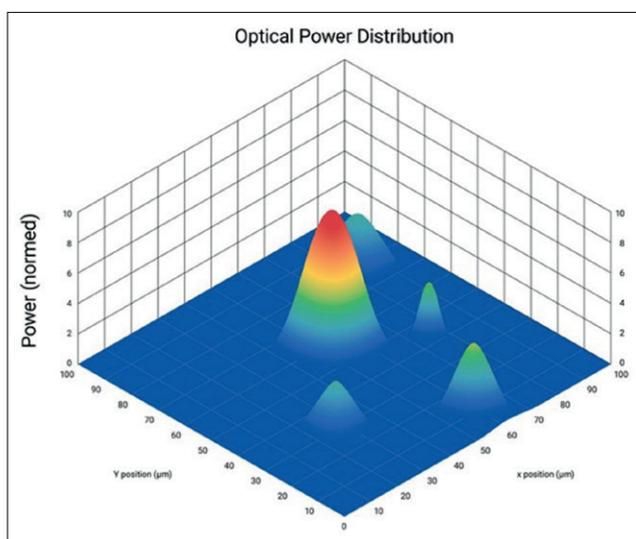


图1：光子元件的光功率分布和模拟爬坡算法（梯度搜索）。（图片由PI提供）

## 劳动密集型器件组装的局限性

光子器件的组装工艺通常包括对于光源、光纤、透镜、阵列、波导和芯片的组合进行仔细的对准、粘合和固化。这些单独的组件中的每一个都必须准确定位，以确保最终产品的预期功能和性能，因为即使是不到百万分之一米的轻微错位，也会严重影响器件的效率。

尽管组装技术取得了进步，但许多制造商仍然依赖手动对准技术，使用垫片进行误差补偿或使用弹性定位环固定硬件。除了耗时之外，这些方法通常还涉及既昂贵又难以找寻的专业化劳动力。

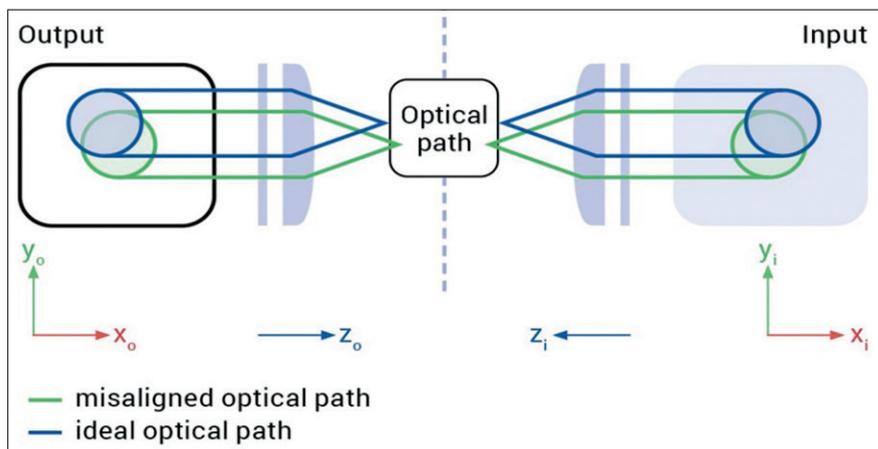


图2：现代光子器件的测试和封装可能是一个跨越多个自由度的巨大挑战。在开发现代并行算法之前，多通道器件（如光纤阵列）的对齐曾经是一个缓慢、重复的过程。（图片由PI提供）

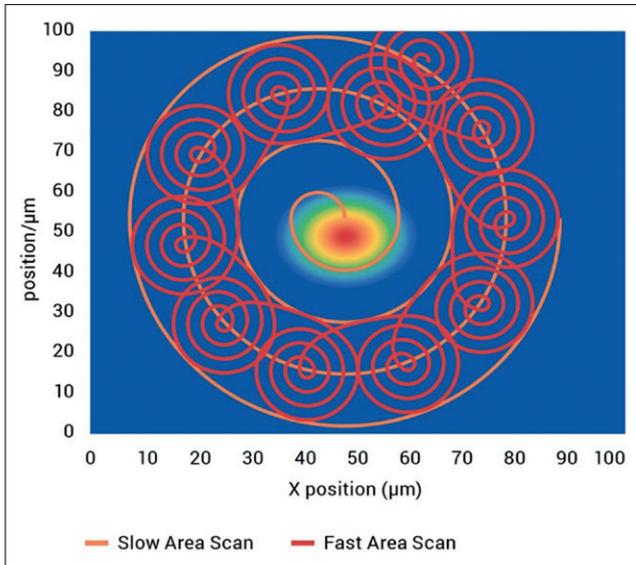


图3: 光学反馈是自动对准的关键。本图中显示了一种快速、传统的方法,即找到第一束光,然后进行梯度搜索以获得最佳耦合效率——使用六足位移台/压电方法的双螺旋扫描。六足位移台运行粗螺旋扫描(粗是指个位数的微米精度),而压电平台则通过高速亚微米扫描填充间隙。精细扫描和粗略扫描可以同时进行。(图片由PI提供)

复杂器件的手动组装可能需要长达20分钟,在组件的定位阶段的生产过程中就造成重大瓶颈。此外,垫片和夹具等传统装配工具可能难以满足制造现代器件所需的日

益严格的公差。因此需要另一种对齐策略来精确指引组件的定位。

### 光学反馈引导自动对准引擎

光子器件的一个关键特性是其效率与各个组件的对准直接相关。这意味着输出强度会随着组件位置而实时地动态变化。不同的信号强度可作为迭代位置调整过程的指示,从而实现精确对齐的组件。为了评估组件漂移,可以在胶粘和固化过程中监测光子输出强度的波动。但是,在具有大量输入和输出的复杂器件中,手动执行此方法就变得不切实际了。优化一个连接可能会导致影响其他连接的运动,因此需要不断重新调整以达成全局的最优。自动化解决方案对于应对这一挑战至关重要,它实现了实用的生产工艺,无需耗时的来回调整过程。

自动化调整工艺包括闭环器件输出和定位硬件之间的反馈回路,允许智能软件解决方案和控制模块进行微调。这些系统利用区域扫描算法来表征组件,确定峰值光子输出的大致位置。然后进行多次梯度搜索以精确确定全局最优值。专用的压电纳米定位装置能够同时调整多个连接,在称为主动对准的创新工艺中引导元件完美地对准。集成

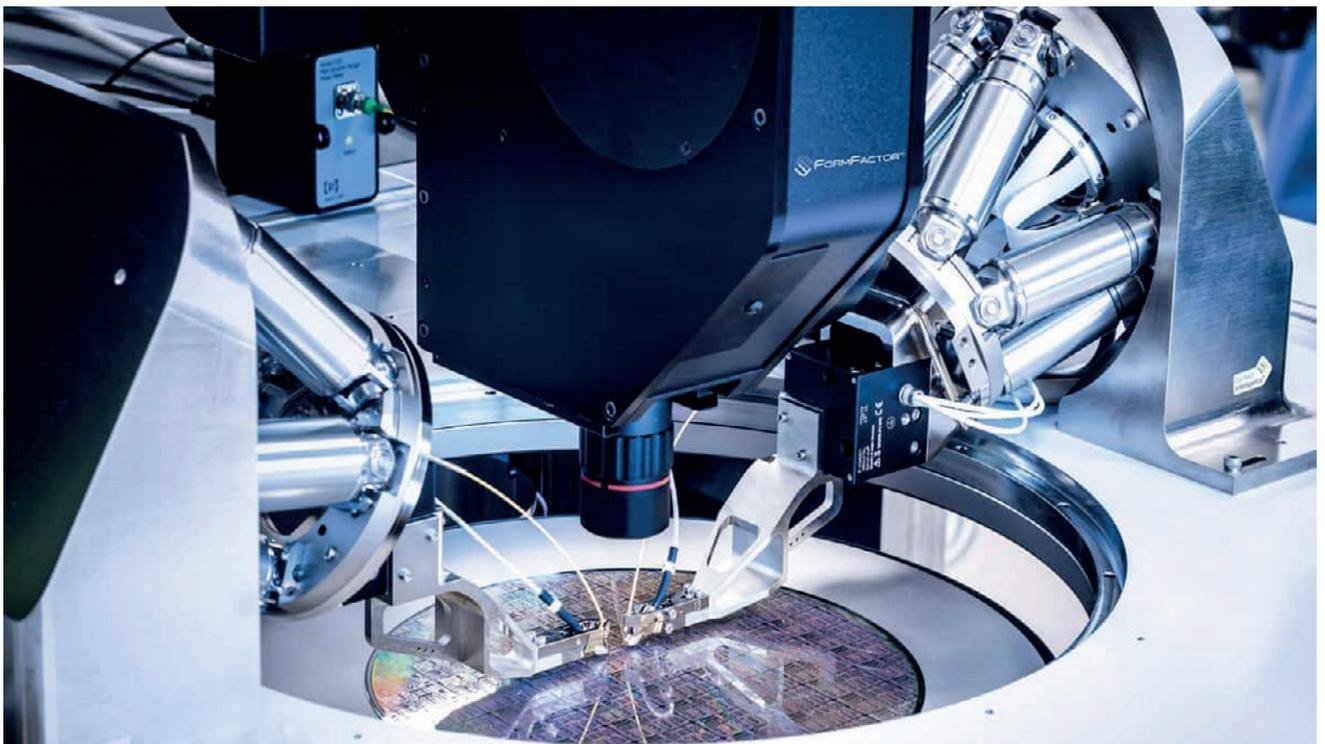


图4: F-712双面18轴快速多通道光子学对准引擎,可在晶圆探针台中对SiP器件进行快速N×M对准。六足位移台提供6个自由度,而紧凑的3轴压电扫描仪可实现纳米分辨率和100Hz的扫描频率,以实现最快的对准速度。Cascade Microtech开创性的CM300xi支持光子学的工程晶圆探针台集成了PI的快速多通道光子学对准引擎,用于晶圆上硅光子器件的高吞吐量、晶圆安全、纳米精度光学探测。(图片由FormFactor提供)



图5: PILightning算法实现了基于空气轴承的双面对准系统。新算法将单面应用中的首次寻光过程缩短了10倍或更多, 将双面应用中的首次寻光过程减少了100倍。(图片由PI提供)。

功能(包括补偿系数)则消除了不断迭代重新调整的需要。

我们现已提供完整的模块化解决方案, 可显著缩短光子器件的制造时间, 同时保持亚微米级的精度。例如, Physik Instrumente 的快速多通道光子对准(FMPA, fast multichannel photonic alignment)技术, 可以在多个自由度上并行执行多个对准, 例如输入和输出, 从而将装配时间缩短100倍甚至更多。

### 解决首次寻光的问题

由于对准是光子器件制造的首要成本驱动因素, 因此自2016年屡获殊荣的快速多通道光子对准(FMPA)技

术问世以来, 解决这一问题一直是PI的重点。FMPA通过跨多个通道、组件和自由度并行执行优化, 并实现通常为0.02dB的耦合可重复性, 减少了光子器件制造和测试的时间和成本, 并提高了良率。但是, 在优化工艺开始之前, 需要检测到高于噪声水平的光信号——这个过程称为首次寻光, 在具有输入和输出的器件中, 它尤其耗时, 因为两侧必须都对齐才能实现阈值耦合量。在所有工业光子器件对准应用中, 包括晶圆探测和器件封装, 首次寻光都是一个耗时的过程。

现在, 一项突破性的发现已经到来, 它以一种新颖的内置搜索和对齐算法(已申请专利)的形式出现, 有望彻底改变这一领域。该算法被称为PILightning, 嵌入运行在PI的高级控制器上。它使压电扫描仪或直接驱动空气轴承平台等高动态机械装置能够实现与以前的首次寻光算法相比的显著生产经济收益。这种新工艺是完全自动化的, 几乎是实时的, 无需大量校准或手动干预。PILightning基于一种新的搜索方法, 集成了基于AI的实时执行功能。它还通过高频数据采样取代了小间距扫描, 显著提高了对准速度。它大大减少了在单面和双面耦合以及环回(omega)波导配置中首次寻光所需的时间。

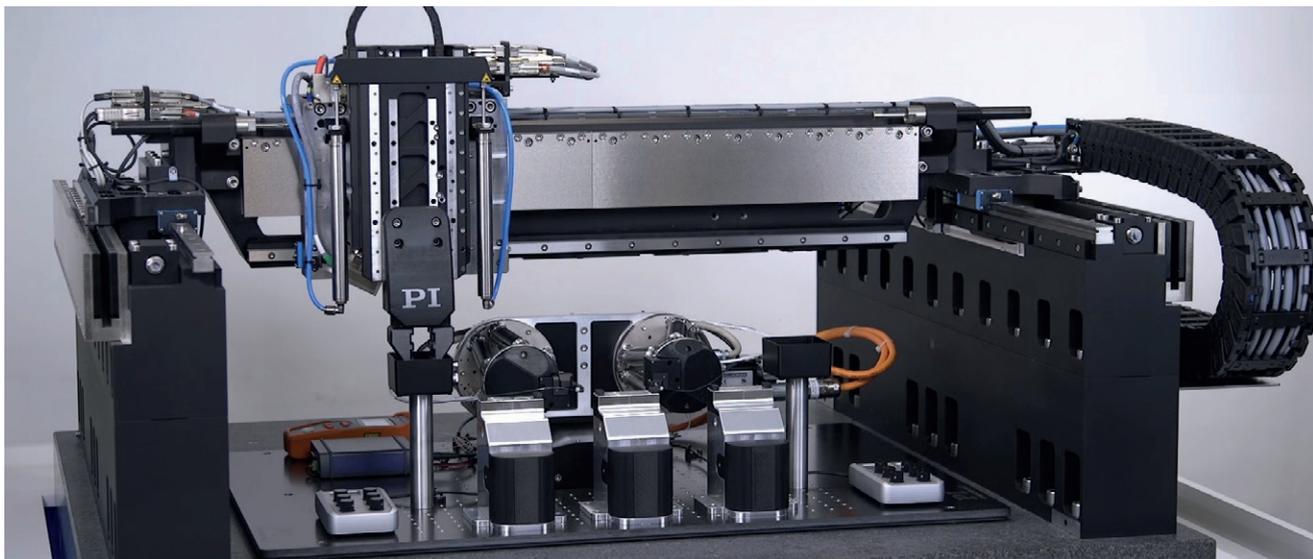


图6: 带有两个六足位移台6轴高速自动对准站的龙门拾取和放置系统, 用于快速硅光组件的测试。(图片由PI提供)

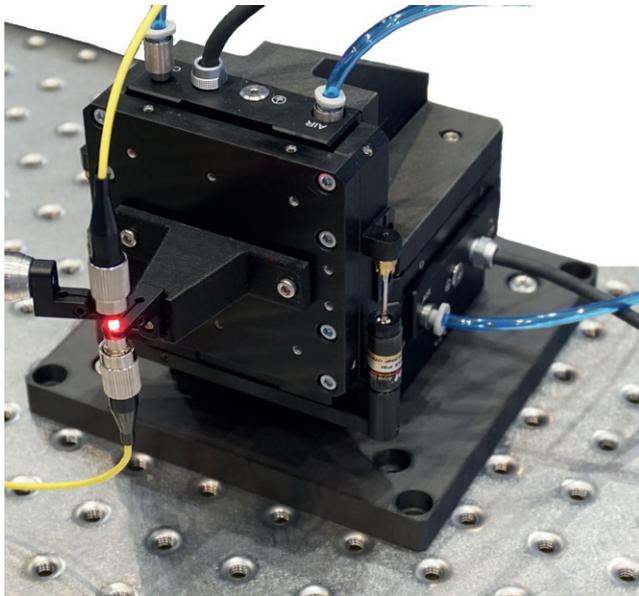


图7：一种紧凑的基于多轴空气轴承的光子元件对准系统。空气轴承的优点是无摩擦、高速运动，使用寿命几乎无限，并且不会产生颗粒。（图片由PI提供）

一旦检测到第一束光，FMPA 快速梯度搜索算法就会接管，利用实时反馈控制快速优化跨自由度和通道的并行对齐。根据应用的不同，还可以激活跟踪算法以保持最大的耦合效率——例如，在固化情况下这很重要。

### 通过基于多种驱动技术的模块化解决方案确保未来的成功

光子器件市场正在迅速发展，预计未来十年将有大量采用该技术的行业出现大幅增长。由于器件具有数百甚至



图8：PI的自动化控制器使用ACS控制器和驱动程序模块以及嵌入式高性能对准算法，以实现最高的数据吞吐量和最短的对准时间。EtherCat®连接允许无缝集成第三方设备。（图片由PI提供）

数千个单独的组件和连接，制造商面临着并行优化的必要性，这使得主动对准成为满足生产需求的最佳选择。

此外，随着光子器件在各个领域受到关注，越来越专业化的器件的开发需要定制的生产工艺。旨在保持竞争力并适应不断变化的需求，制造商需要灵活的硬件和软件组合，并且可以轻松地重新配置。

除了基于“单片式”六足位移台的6轴对准引擎外，以PI开发的模块化对准解决方案为例，在提供生产运营所需的灵活性和可扩展性方面表现出色。这些解决方案包括基于空气轴承的无摩擦运动系统，这些系统需要的维护为零，并提供卓越的速度和使用寿命，以及带有精密机械轴承的线性 and 力矩电机驱动解决方案，以及基于传统螺杆驱动和步进电机的廉价系统。

所有这些模块化系统的共同点是基于 EtherCat® 的高性能运动控制器，具有嵌入式高级对准程序和集成的高速光功率计，可快速取得成功。◆

## 美国对华出口限制措施再升级

2024年12月2日，美国政府宣布了新一轮对华出口限制措施，将140余家中国企业加入贸易限制清单，涵盖半导体生产设备制造商、晶圆厂和投资机构，名单中包括北方华创、拓荆科技、闻泰科技、华大九天、中科飞测等一系列知名公司。此外，文件中还增加了针对24项半导体制造设备的限制，涵盖部分刻蚀、沉积、光刻、离子注入、退火、量测、检查以及清洁工具。同时增加了对电子计算机辅助软件、技术计算机辅助设计软件等技术的限制。不仅如此，还增加了对华出口先进高带宽内存（HBM）的新规则，涵盖美国公司和“长臂管辖”措施影响的外国生产商。

美方的行为再一次破坏了全球半导体产业长期以来达成的公平、合理、无歧视的共识和WTO公平贸易的宗

旨，违背了全球半导体企业共同遵循的世界半导体理事会（WSC）章程精神，伤害了全球半导体从业者团结协作的努力，给全球半导体产业链的安全稳定造成实质性损害。

中国半导体行业协会特别发表声明，对此表示严重关切和坚决反对。声明称：中国半导体产业的发展根植于全球化，成长和壮大于全球化。我们将始终坚持开放合作，积极同各国半导体上下游企业深化合作，促进全球产业的繁荣发展。中国半导体行业协会将维护WSC已形成的公平原则和产业共识，坚决捍卫中国半导体企业及全球供应链合作伙伴利益。呼吁相关国家和地区的企业要努力成为可靠半导体产品供应商，也呼吁中国政府支持可靠半导体产品供应商的稳定发展。



## 突破功率极限

新颖的设计丰富了一系列半导体材料的功率器件的性能

作者：Richard Stevenson, 《COMPOUND SEMICONDUCTOR》杂志

**氮**化镓 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 等被认为只是一种前景看好的材料的时代，已经一去不复返了。现在，它们正在发挥自己的潜力，其显著的商业成功就是明证。由于在电动汽车中的广泛应用，SiC MOSFET 的销量正在飙升，而 GaN 现已成为制造便携式产品快充的材料。

但是，电力电子技术的革命还远远没有结束。在几千伏或更高电压下工作时，领先的器件仍然是硅 IGBT 和晶闸管。然而，一些基于化合物半导体材料的新型替代品有

望取代它们——它们也可能在较低电压下发挥作用。

在加利福尼亚州旧金山举行的 IEEE 国际电子器件会议 (IEDM) 上，展示了这类器件的几个杰出案例。会上探讨了许多进展，其中包括：首次展示了沟槽型 6.5 kV SiC IGBT；GaN HEMT 能够阻断高电压，同时提供超低动态导通电阻；首款由  $Ga_2O_3$  制成的垂直超结器件，其击穿电压达 2 kV；以及基于 AlN 的垂直型 p-n 二极管，采用无掺杂剂分布式极化掺杂，其临界电场几乎是所报道的 SiC 和 GaN 值的两倍。

### 沟槽型SiC IGBT

在国家层面，为减少碳排放所做的努力需要包括引入智能电网和高压直流输电系统。这两项创新的基础包括静态同步补偿器和固态变压器，它们是由能够阻断高电压和提供大电流的功率器件组成的元件。

由 SiC 制成的器件有望成为这些补偿器和变压器的候选器件。SiC 不仅能确保器件的高性能，还能在高频率下工作，这为缩小补偿器和变压器的尺寸和提高其效率打开了大门。不过，如果采用 6.5 kV SiC MOSFET，导通电阻是一个令人担忧的问题，尤其是在高温条件下（175℃时为 104 mΩ cm<sup>2</sup>）。

由于这一限制，许多研究小组已经开发出了 SiC IGBT。其中包括利用厚漂移层实现 15 kV 阻断的产品，以及日立公司首创的变体，其特点是采用更薄的漂移层来降低开关损耗。2016 年，日立公司（Hitachi）的研究人员推出了一款具有低开关损耗的 6.5 kV SiC IGBT，该器件采用了极薄的漂移层，在最近的 IEDM 上，该团队又推出了一种具有沟槽双扩散 MOS 结构的后代产品（见图 1），旨在解决由于沟道迁移率低而导致的发射极电子注入低的问题。

Naoki Watanabe 在他的 IEDM 演讲中描述了这种器件，并强调了传统 SiC 沟槽栅极结构的一个弱点：“在沟槽底部，由于 SiC 的临界电场很高，而 SiC 临界电场靠近栅极氧化物，在关断状态下栅极氧化物中会产生高电场。因此，要实现沟槽栅 SiC IGBT，电场弛豫是必要条件。

为解决这一问题，该团队开发了一种新型的 SiC IGBT，其采用沟槽蚀刻双扩散 MOS 结构。据称，这种采

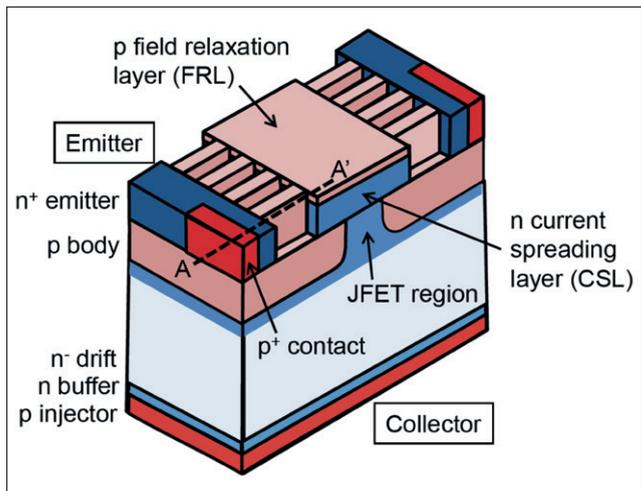


图1. n沟道SiC IGBT，采用沟槽蚀刻双扩散MOS结构。

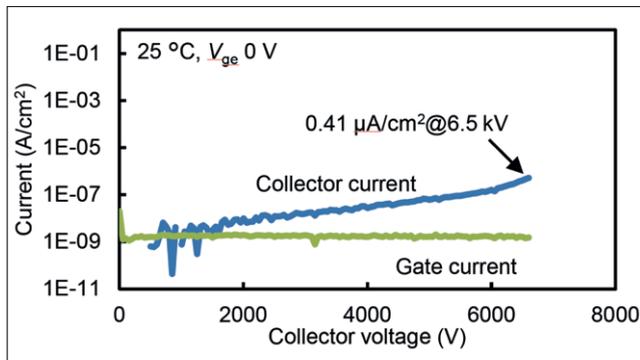


图2. 采用沟槽蚀刻双扩散 MOS 结构的SiC IGBT可实现超过 6.5 kV 的阻断电压。

用 V 型结构的设计的优点之一是通过缩小沟槽间距提高了沟道密度。另一个优点是，在关断状态下工作时，通过将沟槽埋入 p 体，栅极氧化物中的电场大大降低。

为了评估沟槽蚀刻双扩散 MOS 结构的能力，Watanabe 及其同事制作了这种形式的测试结构，然后将其电气特性与平面变体进行了比较。在绘制栅极电压与漏极电流的函数关系图时发现，沟槽蚀刻双扩散 MOS 结构的电流增加了一倍，这要归功于鳍状结构。Watanabe 认为：“因此，沟槽蚀刻双扩散 MOS 结构可以增强发射极的电子注入。”

该团队通过模拟深入了解了该器件在关断状态下的电场，该电场的峰值为 2 MV cm<sup>-1</sup>。Watanabe 说：“这个值很低，足以确保高可靠性。”他还补充说，沟槽蚀刻双扩散 MOS 结构抑制了栅极氧化物中的电场。

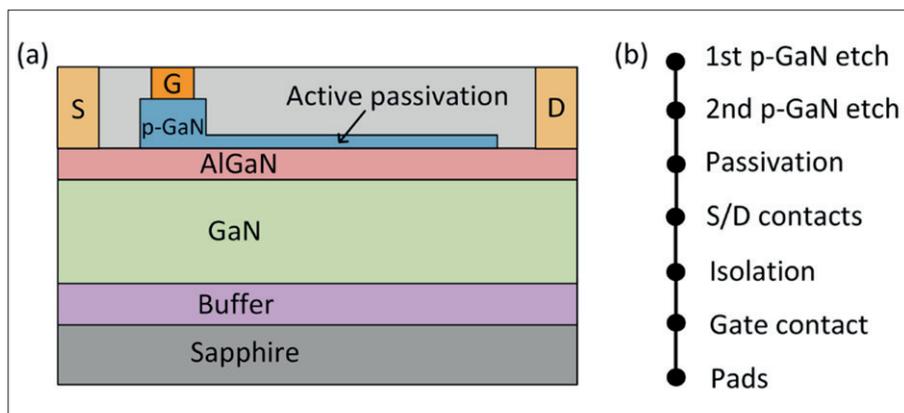
该团队的新型 IGBT 的制造首先采用 n+ 衬底，然后沉积包括 70 μm 厚漂移层的外延结构。最后一道工序是背面研磨，这样就制成了漂移层很薄的 IGBT。

电气特性测量结果表明，采用沟槽蚀刻双扩散 MOS 结构的 IGBT 的导通电压（定义为集电极电流为 200 Acm<sup>-2</sup> 时的电压）为 4.8 V，而平面型的导通电压为 6.7 V。接通时，新型 IGBT 的微分导通电阻为 6.6 mΩ cm<sup>2</sup>，约为平面器件的三分之一。采用沟槽蚀刻双扩散 MOS 结构的 IGBT 在 6.5 kV 电压下的集电极漏电流为 0.41 mA cm<sup>-2</sup>（见图 2），证明了它的阻断能力。

采用沟槽蚀刻双扩散 MOS 结构的 IGBT 开关特性也优于平面控制。关断和导通损耗分别降低了约 19% 和 6%，这要归功于较小的反馈电容和来自发射极的大量电子注入。

### 有源钝化 GaN HEMT

在 IEDM 上展出的另一款器件是 E-mode 有源钝化 p-GaN 栅极 HEMT，它能够提供 6.5 kV 的阻断电压，目



场板的传统方法，因为这种方法对于工作电压超过几千伏的器件来说是不切实际的。

“作为一种替代方法，我们提出了有源钝化 p-GaN 栅极 HEMT，” Jiawei Cui 解释说，在这种晶体管中，减薄的 p-GaN 层起到了钝化作用（见图 3）。这种形式的 HEMT 还具有其他特点，如屏蔽移动空穴的表面捕获，以及只需一个额外步骤就能实现有源钝化。

图 3. 有源钝化 HEMT 的结构 (a) 及其制造工艺概要 (b)。

标市场是未来的电网基础设施。

这种在蓝宝石衬底上生长的横向 GaN HEMT 由北京大学、清华大学和名古屋大学的研究人员合作开发，其优点包括不需要厚外延结构，并有机会将同一外延片用于低压和高压器件。

北京大学的 Jiawei Cui 代表团队发言时指出，开发千伏级 GaN 功率开关时，面临的两大挑战是确保增强型模式工作（即器件通常处于关断状态）和动态导通电阻的稳定性。

Jiawei Cui 表示：“p-GaN 栅极 HEMT 是 E-mode GaN 功率晶体管的主流技术。为了充分利用过去几年积累的经验，我们认为将 p-GaN 栅极结构用于高压晶体管也是一个不错的选择。”

为了抑制动态导通电阻，崔和同事们放弃了增加多个

在制造器件时，首先要使用传统的外延片，该外延片具有高电阻率缓冲层、200 nm 厚的未掺杂 GaN 沟道、15 nm 厚的  $Al_{0.2}Ga_{0.8}N$  势垒和 20nm 厚的 p-GaN 盖帽，并通过两步工艺对该层进行选择性蚀刻。然后沉积二氧化硅使器件钝化，再加入欧姆触点、隔离步骤以及形成栅极触点和探针 pad。

电学测量显示，有源钝化 HEMT 的关态阻断能力优于作为对照器件的传统 HEMT。对于这两种器件，栅极长度的增加会导致更高的阻断电压，栅极长度为  $77\mu m$  的有源钝化 HEMT 能够阻断 6.573 kV 的电压（见图 4）。研究小组认为，有源钝化 HEMT 的阻断电压之所以更高，是因为耗尽区的位置发生了变化，不再部分位于栅极下方。

根据对传输电流 - 电压特性的测量，这两种形式的 HEMT 都呈现出增强型模式工作，阈值电压为 0.8 V。

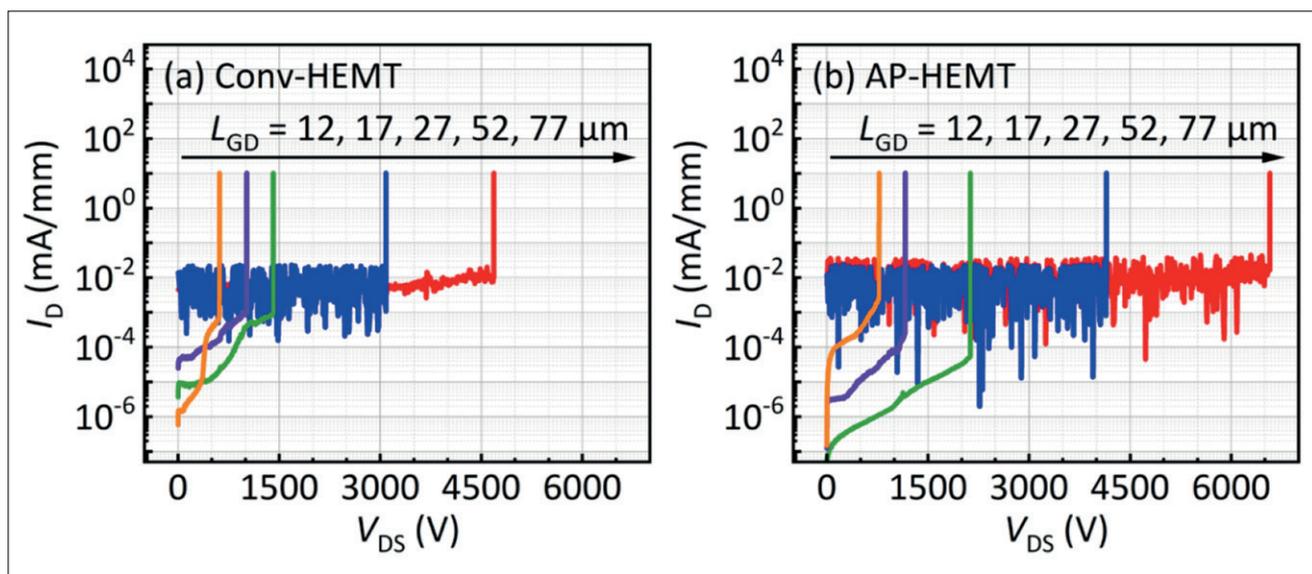


图4.传统GaN HEMT的关断特性 (a) 不如采用有源钝化设计的变体 (b)。

对输出电流 - 电压特性的测量结果表明，有源钝化 HEMT 的导通电阻低于对照组，分别为 38.2 mΩmm 和 43.6 mΩmm。

为了评估其器件的动态导通电阻，崔和同事比较了一系列漏极 - 源极电压下的动态值和静态值。据报道，在 4.5 kV 电压下对栅极长度为 77μm 的增强型 p-GaN 栅极 HEMT 进行测量时，该比率为 1.02。

据称，优良的导通电阻特性源于钝化层的屏蔽效应。为了验证这一结论，研究团队制作了一对器件——带有源钝化和不带有源钝化——其中包括一个表面测试电极。

在该电极上施加负电压可模拟负表面捕获效应。崔说：我们发现，传统 HEMT 的漏极电流减小了，但有源钝化 HEMT 的漏极电流保持不变。这一结果表明，有源钝化可以屏蔽表面效应对 2DEG 沟道的影响。

研究人员还进行了第二项测试，在电极上施加正电压以在表面捕获电子。去掉电压后，传统 HEMT 的漏极电流减小，需要很长时间才能恢复。相比之下，有源钝化 HEMT 的漏极电流没有变化，进一步证明了表面屏蔽的作用。

崔最后对有源钝化 HEMT 进行了基准测试。他声称，该器件的性能接近 SiC 极限，是第一个阻断电压达到或超过 6.5 kV 的增强型 p-GaN 栅极 HEMT。

### Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 超结肖特基整流器

美国和日本的研究人员合作开发出了另一个新的突破：首个由超宽禁带材料 Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 制成的垂直超结器件。

弗吉尼亚理工学院和州立大学、南加州大学、美国海军研究实验室、Novel Crystal Technology 公司和橡树岭国

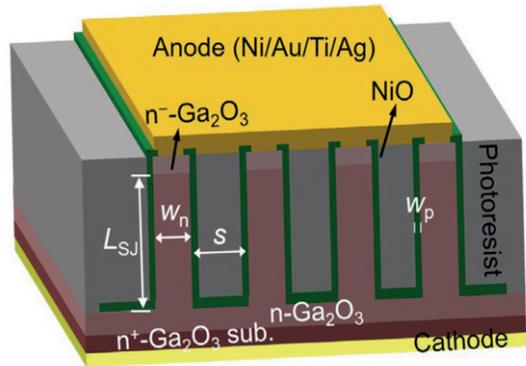


图5. 垂直 Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 超结肖特基势垒二极管的特性由沟道深度 ( $L_{sj}$ )、沟道宽度 ( $W_n$ )、沟道间距 ( $S$ ) 和氧化镍厚度 ( $W_p$ ) 等关键尺寸决定。

家实验室的研究人员合作一系列器件，这些器件的支柱宽 1-2μm，包裹在电荷平衡的 p 型 NiO 中。这些器件可阻断高达 2 kV 的电压。

弗吉尼亚理工学院和州立大学的 Yuan Qin 代表合作伙伴发言。他首先强调了 Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的优势。这些优势包括临界电场高（预计可达 8 MV cm<sup>-1</sup>）、温度稳定性高以及可在大直径衬底上外延生长。遗憾的是，这种氧化物有两大缺点：缺乏 p 型掺杂和热导率低。

Qin 简要介绍了各种形式半导体器件的发展历程，他解释说，从一维结构到多维变体（如采用超结、多通道和多栅极的器件）的转变，在系统层面实现了更高的功率密度和效率。

对于超结器件，例如 Qin 及其同事制备的器件，导通电阻随阻断电压呈线性增长，而对于一维器件，导通电阻则随阻断电压的平方而变化。

Qin 说：“对于超宽禁带半导体氧化镓而言，制备超结器件仍面临一些挑战，”他解释说，其中之一是开发一

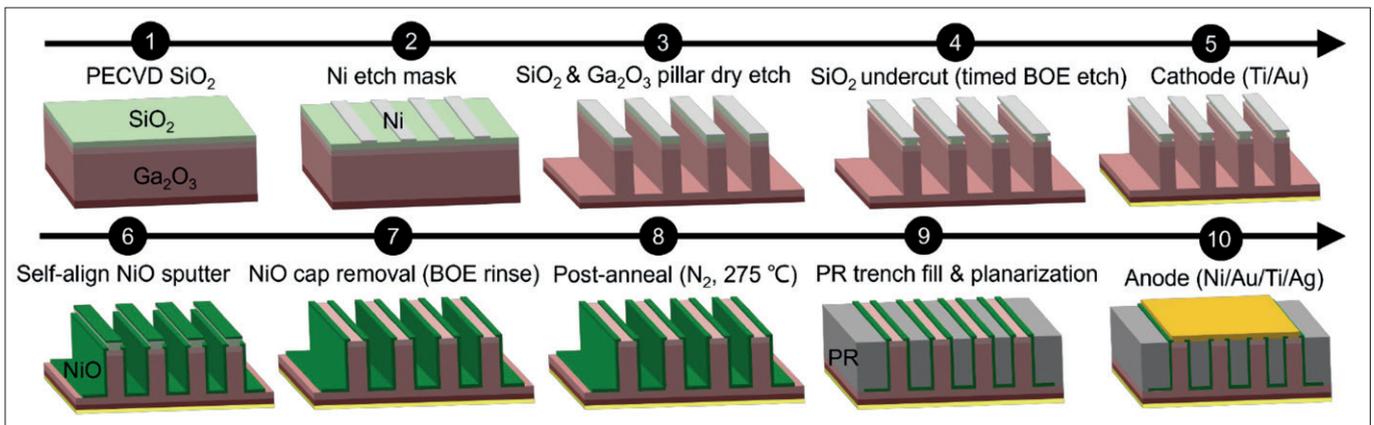


图 6. 制备 Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 超结肖特基势垒二极管的十个步骤。

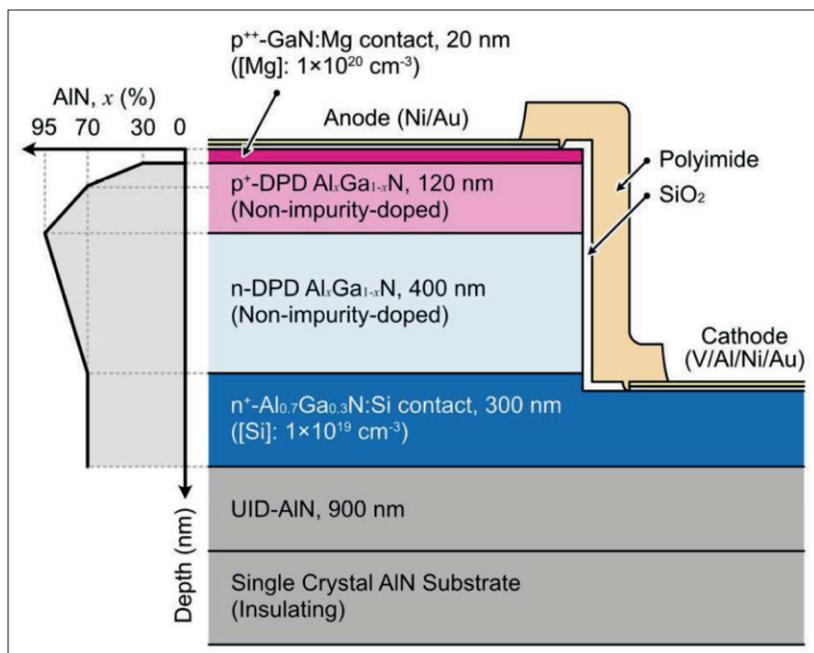


图7.分布式极化掺杂用于形成AlN基二极管。

种能产生垂直侧壁和光滑表面的深柱蚀刻工艺。

由于缺乏 p 型  $\text{Ga}_2\text{O}_3$ ，器件开发还需要选择一种不会导致过多界面陷阱的替代 p 型材料。NiO 显然是一个候选材料——它以前曾用于制备 GaN 的垂直超结和  $\text{Ga}_2\text{O}_3$  的横向超结。

超结器件的制备涉及对 NCT 生产的 2 英寸  $\text{Ga}_2\text{O}_3$  外延片的处理，该外延片有  $10\mu\text{m}$  厚的 n- $\text{Ga}_2\text{O}_3$  层（掺杂水平为  $2 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ ）和  $0.5\mu\text{m}$  厚的 n- $\text{Ga}_2\text{O}_3$  层（掺杂水平为  $1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ）。干法蚀刻产生了  $6.5\mu\text{m}$  深的柱子，在氩气和氧气环境中通过共形溅射将其包裹在 NiO 中。由于 NiO 中的受主浓度远高于  $\text{Ga}_2\text{O}_3$  柱中的施主浓度，因此厚度为  $120\text{nm}$  的 NiO 可与  $1.2\mu\text{m}$  宽的柱子实现电荷平衡。研究小组通过在沟槽中填充光刻胶并添加 Ni/Au/Ti/Ag 肖特基触点，完成了器件的制备（器件结构见图 5，工艺流程详情见图 6）。

在这种设计中， $0.5\mu\text{m}$  厚的顶部 n- $\text{Ga}_2\text{O}_3$  层有两个作用：降低肖特基触点的隧穿漏电流；将峰值电场的位置从肖特基触点转移到体超结。

Qin 及其同事评估了具有各种柱宽的超结器件的阻断能力。他们发现，击穿电压最初随支柱宽度的增加而增加，在支柱宽度为  $1.8\mu\text{m}$  时达到  $2\text{kV}$ ，而在更宽的支柱宽度时则有所下降。峰值阻断能力源于最佳电荷平衡。

当器件温度升高到  $175^\circ\text{C}$  时，研究小组观察到阻断

电压小幅下降到  $1.8 \text{ kV}$ 。这表明电荷平衡在高温下得以保持。

对于阻断电压最好的器件，室温下的导通电压为  $1 \text{ V}$ ，通断比约为  $10^9$ ，比导通电阻仅为  $0.7 \text{ m}\Omega\text{cm}^2$ 。在  $175^\circ\text{C}$  时，导通电压降至  $0.8 \text{ V}$ ，通断比约为  $10^8$ ，比导通电阻为  $1.3 \text{ m}\Omega\text{cm}^2$ 。

在该器件进行基准测试后，Qin 指出，在  $600 \text{ V}$  至  $4 \text{ kV}$  的所有肖特基势垒二极管和结势垒肖特基二极管中，该器件在比导通电阻和击穿电压之间实现了最佳折衷。该团队的器件可提供快速开关，其性能接近 GaN 的一维极限。

### AlN 垂直型 p-n 二极管

在硅的所有替代品中，AlN 可以说是最有前途的。由于具有  $6 \text{ eV}$  的带隙，它的临界电场远高于所有竞争对手，这表明它有可能在阻断电压和比导通电阻之间做出更好的权衡。

多年来，AlN 器件的缺点之一是一直缺乏同质衬底。不过，近年来 AlN 器件已取得了很大进展，2022 年的报告显示，这种材料中的螺旋位错密度可低于  $10^4 \text{ cm}^{-2}$ ，而旭化成公司也于 2023 年宣布推出直径为 4 英寸的衬底。

AlN 的另一个问题是难以实现导电层。由于常见掺杂剂的电离能较高，硅施主的电离能为  $282 \text{ meV}$ ，镁受主的电离能为  $630 \text{ meV}$ ，因此通过传统方法实现室温导电是一项挑战。

分布式极化掺杂提供了一种解决方案，这种方法是加州大学圣巴巴拉分校 20 多年前首创的。在氮化物合金中，p 型和 n 型电导率都可以通过使用梯度合金方向的正或负固定空间电荷来实现。

在这种方法的基础上，名古屋大学和旭化成公司团队利用分布式极化掺杂法在 AlN 基激光二极管中产生了一个 p 型层。据说，这种生产 p 型层的方法可以提高注入效率和微调串联电阻，并最终实现在紫外线下连续发射激光。

在 IEDM 会议上，该团队宣布在分布式极化掺杂方面取得了进一步的成功。利用它在 AlN 基的垂直 p-n 二极管中生产出 p 型和 n 型层。

来自名古屋大学的 Takeru Kumabe 向 IEDM 代表解释说，在他们团队最近取得成功之前，铝成分超过 30% 的

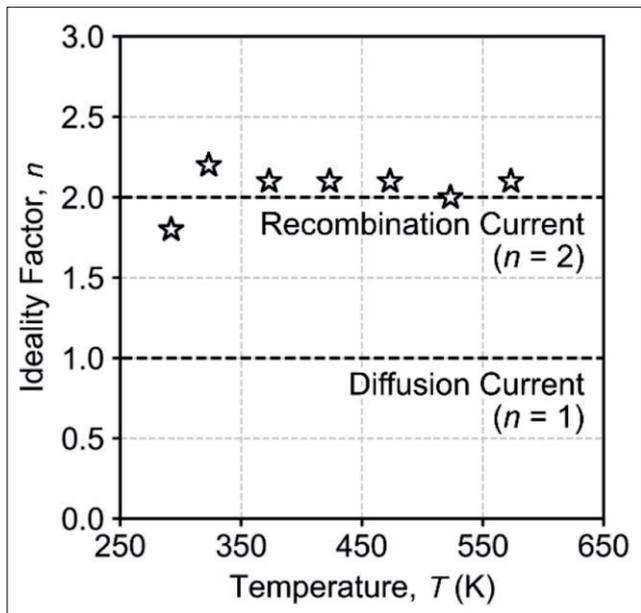


图8. AlN二极管随温度变化的理想因子接近 2，这表明电子和空穴都在器件工作中发挥作用。

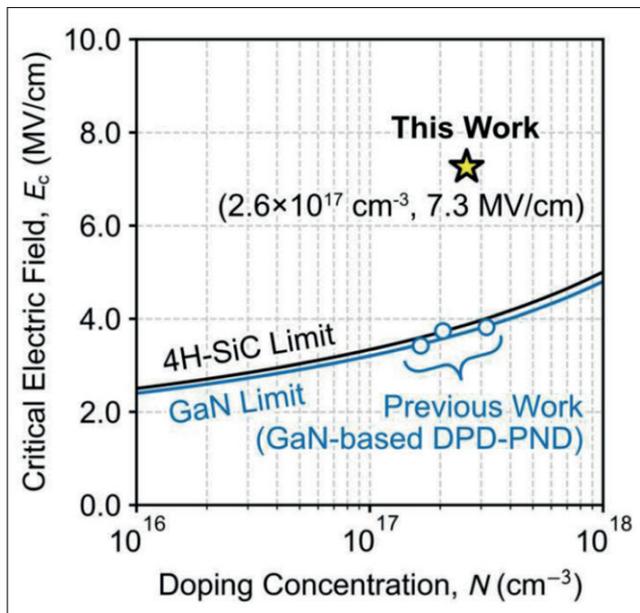


图9. 采用分布式极化掺杂的AlN基二极管的性能远远超过了 SiC 和 GaN 的极限。

AlGaN 二极管还没有表现出理想的电气特性。

Kumabe 及其同事制备器件的方法是，在 AlN 衬底上生长出 300 nm 厚的  $Al_{0.7}Ga_{0.3}N$  接触层，然后是 400 nm 厚的分布式极化掺杂 AlGaN n 型层、120 nm 厚的分布式极化掺杂 p 型层，最后是 20 nm 厚的镁掺杂 GaN 接触层。在分布式极化掺杂层中，AlGaN 层的铝含量从 70% 到 95% 不等。

二极管的制备始于盖层中镁掺杂剂的活化。在添加阴极、阳极和接触 pad 以及防止空气放电的聚酰亚胺表面保护层之前，蚀刻工艺确定了垂直网格，等离子体增强 CVD 提供了  $SiO_2$  保护层。

二次离子质谱法 (SIMS) 测定的负电荷和正电荷浓度平均值分别为  $1.8 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$  和  $2.6 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ 。Kumabe 解释说：在这两个分布式极化掺杂层中，电荷浓度沿深度方向恒定不变，这要归功于线性成分分级。

在室温下对二极管进行的电气测量显示，其导通电压为 6.5 V，比导通电阻为  $3 \text{ m}\Omega\text{cm}^2$ 。据 Kumabe 称，这是迄今所报道的 AlN 基的 p-n 二极管的最小比导通电阻值。

研究小组还利用电致发光 (EL) 来仔细研究其器件的特性。Kumabe 说：EL 发射随着电流的增加而增加，这表明电子和空穴都有助于典型 p-n 二极管的传导。

为了验证他们的器件是否是真正的 p-n 二极管，Kumabe 和同事在 323K 至 573K 的温度范围内测量了电

流密度与正向偏压的函数关系。发现阈值电压随着温度的升高而降低。使用复合电流模型来描述电学特性，进一步证明了该团队的器件表现为 p-n 二极管，而不是具有金属-绝缘体-半导体结构的器件（见图 8）。

反向偏压测量显示，器件在 -283 V 时发生了破坏性击穿，这表明雪崩击穿并未发生。因此，Kumabe 及其同事计算出击穿时的电场为  $7.3 \text{ MV cm}^{-1}$ 。

“将提取的电场与碳化硅和氮化镓的电场极限，以及之前报道的分布式极化掺杂 GaN p-n 二极管的电场极限进行了比较。”Kumabe 说。 $7.3 \text{ MV cm}^{-1}$  这一数值几乎是相同掺杂浓度下氮化镓和碳化硅极限值的两倍。

Kumabe 还指出，他们的器件打破了在 GaN 衬底上使用分布式极化掺杂 GaN 二极管所能实现的极限。

Kumabe 总结说：“这一结果证明了氮化铝和高铝含量氮化铝镓在功率器件应用中的巨大潜力。”

这些工作表明，AlN 器件正在取得巨大进步。除了在 IEDM 和其他会议上报告的 SiC、GaN 和  $Ga_2O_3$  器件的进展之外，毫无疑问，电力电子器件的革命正在顺利进行，但更多的进展还在后面。◆

# 芯粒时代即将到来：这对您有何益处？

作者：Guillaume Boillet, Arteris 公司

**最**近，关于芯粒 (chiplet) 的讨论很多，也很热闹，但也有很多困惑。目前有哪些产品可用？互操作性如何？新兴生态系统的前景是否真实？更重要的是，高端系统级芯片 (SoC) 的开发人员需要考虑一个核心问题：“这对我有何益处？” -- 答案取决于这些芯粒的应用类型和目标市场。

在过去的几年里，我一直在密切关注多芯片 (multi-die) 市场，并与从芯片设计人员到芯片制造商，再到我们系统 IP 产品的最终用户的大量参与者进行了交流。尽管评论家和利益相关者准确地描述了芯粒技术的关键优势，但我观察到这些描述很少是全面的，而且往往缺乏条理。因此，我觉得有必要确定共同的主题，认真思考它们对未来部署的重要性，并将它们映射到关键的行业垂直领域中。本文用图表的形式总结了这些见解 (参见图 1)，希望对您有所帮助。

## 可扩展性：满足多样化计算需求的关键

可扩展性处于芯粒革命的最前沿。传统的单片式芯片设计在接近摩尔定律的边界时面临物理和经济限制。但是，

芯粒提供了一种模块化方法。通过组合更小的分立组件或“芯粒”，制造商可以创建体积更大、功能更强大的处理器。这种模块化设计能够轻松扩展性能和功能，以满足各种应用的特定需求。这正是推动企业计算领域的先驱公司早期采用该技术的原因。如今，它还吸引了通信和汽车行业的参与者，这些行业也渴望更高的计算能力，尤其是在人工智能应用上。

## 成本效益：降低费用，提高竞争力

成本效益是推动采用芯粒技术的另一个关键因素。传统的芯片制造，尤其是在尖端技术领域，成本极其高昂，而且随着晶体管的缩小，成本不断攀升。芯粒方法通过以下几种方式降低了这些成本。首先，它允许对某些组件使用更旧、更具成本效益的制造工艺。其次，通过用多个更小的芯粒来构建处理器，制造商可以显著降低与大型单片芯片缺陷相关的良率损失。即使一个芯粒的一部分出现缺陷，也不会像传统设计那样导致整个芯片无法使用。这直接转化为成本节约，使高性能计算更

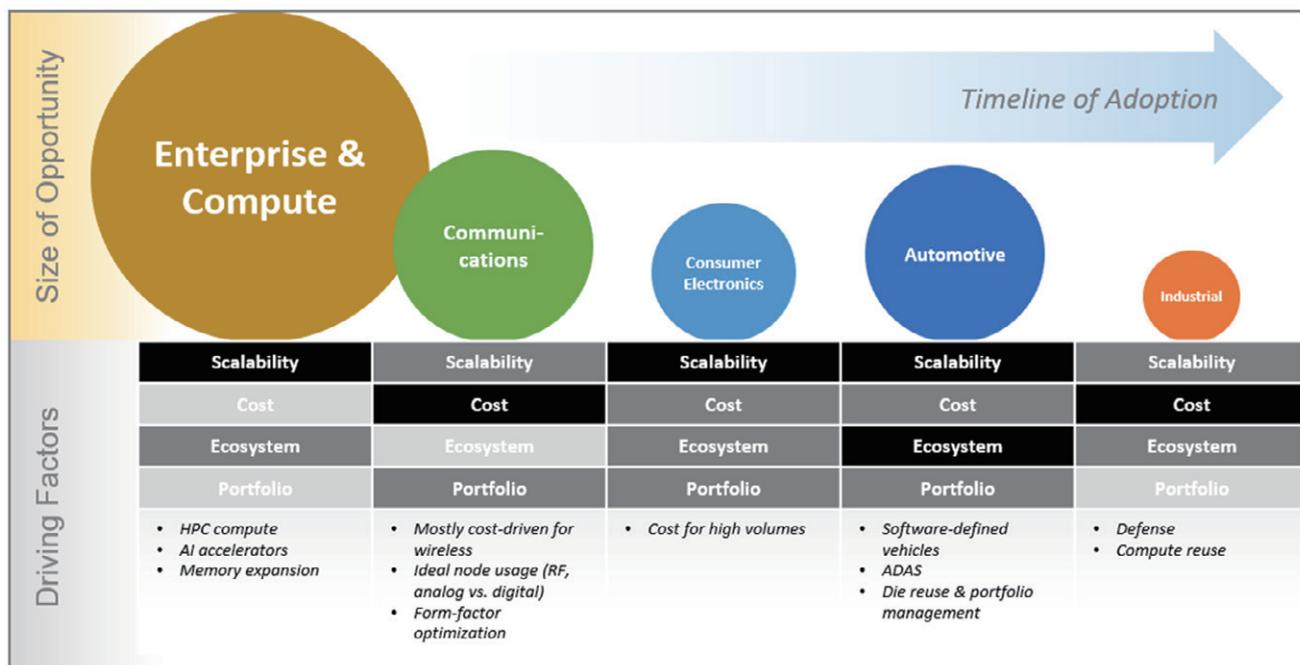


图 1: 芯粒驱动因素和每个垂直领域的机会大小。(图片由 Arteris 提供)

# 使用建模和仿真设计电动汽车的安全电池管理系统

**安**全性是电动汽车 (EV) 的首要关注点。锂离子电池是电动汽车的典型选择，其能量密度高，如果操作条件偏离电池的设计条件，则会带来故障风险。电池管理系统 (BMS) 对于防止负面后果至关重要，包括热失控（一种导致电池损坏的不可控放热反应）。BMS 的主要功能包括监测电流、电压和温度、防止过度充电和过度放电、平衡电池间的电荷、估计电池的荷电状态 (SOC) 和健康状态 (SOH)，以及控制电池组的温度。这些功能至关重要，因为它们影响电动汽车的性能、安全性、电池寿命和用户体验。例如，通过防止过度充电和超过电压限制的放电，BMS 可以防止电池过早老化，确保车辆在其使用寿命内保持高性能。

## 仿真在 BMS 开发中的优势

工程师使用行为模型在台式计算机上仿真电池厂模型、环境和 BMS 算法。他们使用桌面仿真来探索新的设计理念，并在制作硬件原型之前测试多种系统架构。桌面仿真使工程师能够验证 BMS 设计的功能方面。例如，工程师可以探索不同的平衡配置来评估它们之间的适用性和权衡。仿真对于需求测试也起到了重要作用；例如，工程师可以在出现隔离故障的情况下验证接触器的行为是否正确。评估故障期间系统的行为是使用仿真取代硬件测试的另一个明显例子。

一旦使用桌面仿真验证了设计，工程师就可以自动生成 C 或 HDL 代码以进行快速原型 (RP) 或硬件在环 (HIL) 测试，以进一步验证实时运行的 BMS 算法。通过 RP，可以从 BMS 算法模型生成代码并将其部署到执行生产微控制器功能的实时计算机中。利用自动代码生成，只需数小时（而不是数天）即可在实时硬件上测试模型中的算法更改。在 HIL 测试的情况下，代码是从电池厂模型而不是 BMS 算法模型生成的，从而提供代表电池组、有源和无源电路元件、负载、充电器和其他系统组件的虚拟实时环



图1：锂离子电池是电动汽车的典型选择，其能量密度高，如果操作条件偏离电池的设计条件，则会带来故障风险。

境。该虚拟环境使工程师能够在开发硬件原型之前实时验证 BMS 控制器的功能。

仿真使工程师能够大幅缩短从设计到代码生成的时间，从而能够以更快的速度和更高的效率对各种技术进行快速建模。Altigreen Propulsion Labs 的工程师使用基于仿真的方法来建模并迭代测试不同的 SOC 估计技术，例如卡尔曼滤波和库仑计数，并设计了一个全面的 SOC 估计技术。Altigreen 首席工程师兼控制系统主管 Prathamesh Patki 表示，“Embedded Coder® 将开发时间缩短了一半。我们的任何设想，都可以在最短时间内在真实硬件上付诸实现。”

## BMS 开发中的建模和仿真用例

电池特性是将电池模型与实验数据拟合的过程。准确的电池特性至关重要，因为 BMS 算法使用电池模型来设置控制参数，例如用于 SOC 估计的卡尔曼滤波器或基于 SOC 的功率限制以及温度以避免欠压或过压情况。在 BMS 开发后期，工程师可以使用相同的电池模型进行系统级闭环桌面和实时系统仿真。Simscape™ Battery™ 等工具提供了多种电池建模方法，包括等效电路、电化学和使用神经网络的降阶建模。

充电速度是电动汽车设计和采用的一个关键性能指

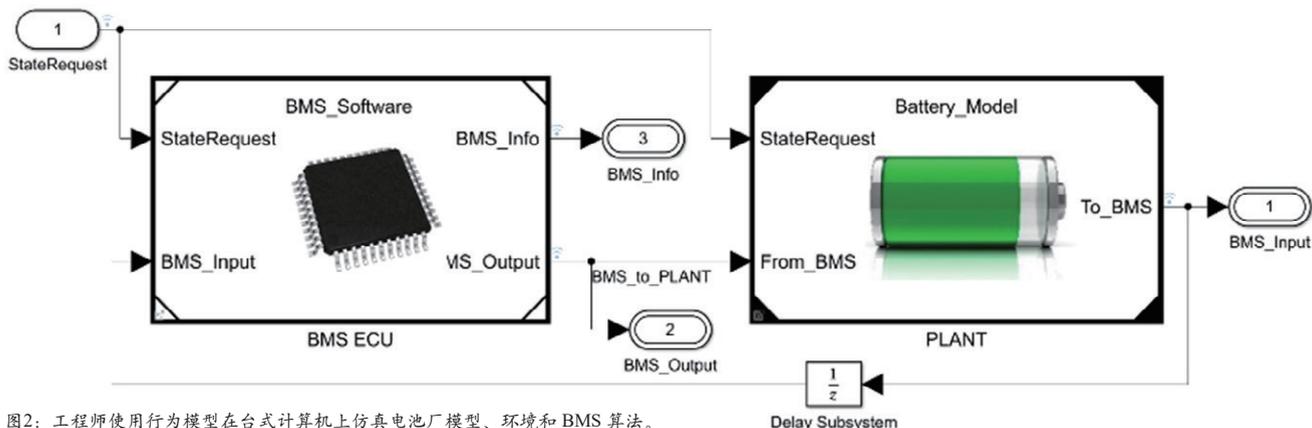


图2: 工程师使用行为模型在台式计算机上仿真电池厂模型、环境和 BMS 算法。

标。快速充电的高功率水平会给电池材料带来压力并缩短其寿命。因此，优化快速充电期间的功率分布以确保最大的充电速率和最小的电池压力至关重要。这是通过仿真和优化的结合实现的。充电时间被最小化，同时压力因素被保持在可接受的范围内。

生产代码生成补充了符合汽车行业正式认证标准的 BMS 设计工作流程。例如，当 LG Chem (现为 LG Energy Solution) 为沃尔沃 XC90 插电式混合动力车开发了 BMS，AUTOSAR 是一项要求标准。LG Chem 选择将 BMS 算法和行为建模和仿真作为其设计工作流程的一个组成部分。每次软件发布时发现的软件问题数量从大约 22 个减少到

不到 9 个——远低于项目目标。LG Chem 使用 AUTOSAR 为沃尔沃开发的 BMS 已获得基于 ISO 26262 功能安全的汽车安全完整性等级 C (ASIL C) 认证。

### 结束语

BMS 设计中的建模和仿真可以缩短开发周期、降低成本并实现更安全、更高效的电动汽车。通过在所有可能的操作和故障条件下运行 BMS 算法，工程师可以更加确信 BMS 软件将在实际系统中处理这些情况，从而减少了昂贵测试的需要。最终，这种方法确保最终产品超出行业标准 and 消费者期望。◆

上接第34页

容易实现。这对于成本敏感型行业尤为重要例如无线通信、消费电子和工业应用。

### 生态系统发展：促进协作与创新

向芯粒的转变也促进了半导体行业协作和创新生态系统的发展。借助芯粒，不同的公司可以专注于各种类型的计算主机和加速器，为更大的整体贡献自己的专长。这种开放性可以带来一个更有活力的生态系统，因为规模较小的参与者可以在特定领域进行创新，而无需承担设计整个芯片的开销。这种协作可以加快技术进步，使汽车和消费电子等垂直领域的新公司受益，并带来更快的技术迭代和改进。

### 产品组合管理：产品开发的战略方法

最后，向芯粒的过渡可以让公司更有效地管理其产品组合。由于具有了混合和匹配不同芯粒的能力，公司可以

更快速、更高效地调整其产品以满足市场需求。这种灵活性可以更快地响应新兴趋势和客户需求，从而提供竞争优势。此外，因为能够在多个产品中重复使用芯粒，可以简化研发工作，缩短产品上市时间，减少研发费用。针对不同配置混合和匹配芯粒的灵活性，使定制芯片以满足特定细分市场变得更容易，尤其适用于消费和汽车市场的需求。

总体而言，芯粒架构有望彻底改变半导体行业，该行业的每个部分都能在其能力中发现独特的价值。这种量身定制的方法确保芯粒将在推动行业各垂直领域的技术进步方面发挥关键作用，而我们 Arteris 将继续提供解决方案来满足各种需求。◆



**Guillaume Boillet** 是 Arteris 产品管理和战略营销高级总监，负责推动互连 IP 和 SoC 集成自动化产品组合的产品生命周期。

# 打造“CPU+”异构计算平台， Arm 灵活应对各类 AI 工作负载

对于人工智能 (AI) 而言，任何单一硬件或计算组件都无法成为适合各类工作负载的万能解决方案。AI 贯穿从云端到边缘侧的整个现代计算领域，为了满足不同的 AI 用例和需求，一个可以灵活使用 CPU、GPU 和 NPU 等不同计算引擎的异构计算平台必不可少。

依托于 Arm CPU 的性能、能效、普及性、易于编程性和灵活性，从小型的嵌入式设备到大型的数据中心，Arm CPU 已经为各种平台上的 AI 加速奠定了基础。

就灵活性而言，这对生态系统大有裨益的三个主要原因是，首先，Arm CPU 可以处理广泛的 AI 推理用例，其中许多用例通常用于数十亿台设备，例如当今的智能手机、云和数据中心。不仅如此，除了推理之外，CPU 还经常用于技术栈中的数据预处理和编排等其他任务。其次，开发者能够在更多种类的数据格式中运行更广泛的软件，而无需构建多个版本的代码。最后，CPU 的灵活性使之成为加速 AI 工作负载的理想工具。

## 提供多样性和选择，助力行业灵活部署 AI 计算

除了 CPU 产品组合外，Arm 计算平台还包括 GPU 和 NPU 等 AI 加速器技术，许多市场都在将这些技术与 CPU 进行集成。

在移动端领域，Arm 终端计算子系统 (CSS) 包含 Armv9.2 CPU 集群，并与 Arm Immortalis-G925 GPU 集成，可为各种 AI 用例提供加速功能，包括图像分割、对象检测、自然语言处理和语音转文本等用例。在物联网 (IoT) 方面，Arm Ethos-U85 NPU 可与需要加速 AI 性能的基于 Arm Cortex-A 的系统一起设计，例如工厂自动化等场景。

此外，除了 Arm 自己的加速器技术外，合作伙伴借助 Arm 的 CPU 灵活定制具有差异化的芯片解决方案。例如，NVIDIA 用于 AI 基础设施的 Grace Blackwell 和 Grace Hopper 超级芯片均采用了 Arm CPU 和 NVIDIA 的 AI 加速器技术，从而显著提升 AI 性能。

NVIDIA Grace Blackwell 超级芯片将 NVIDIA 的

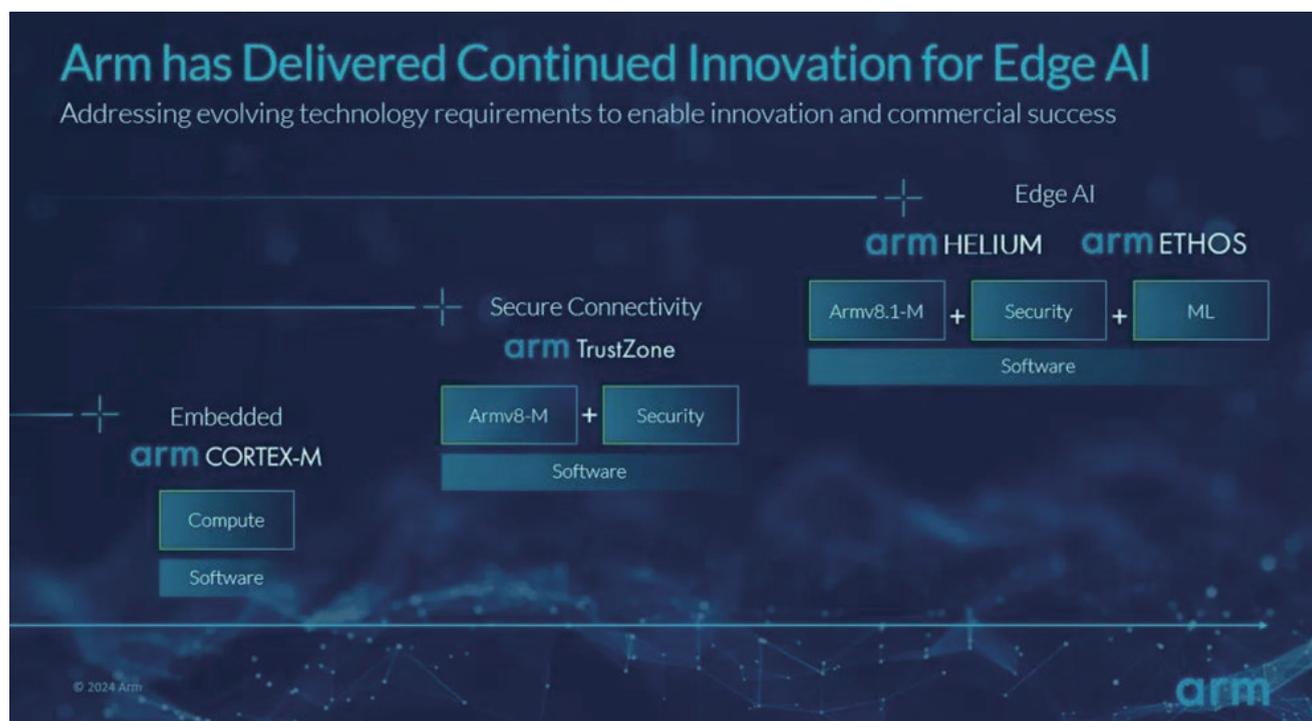


图1: Arm 赋能边缘 AI 持续创新。

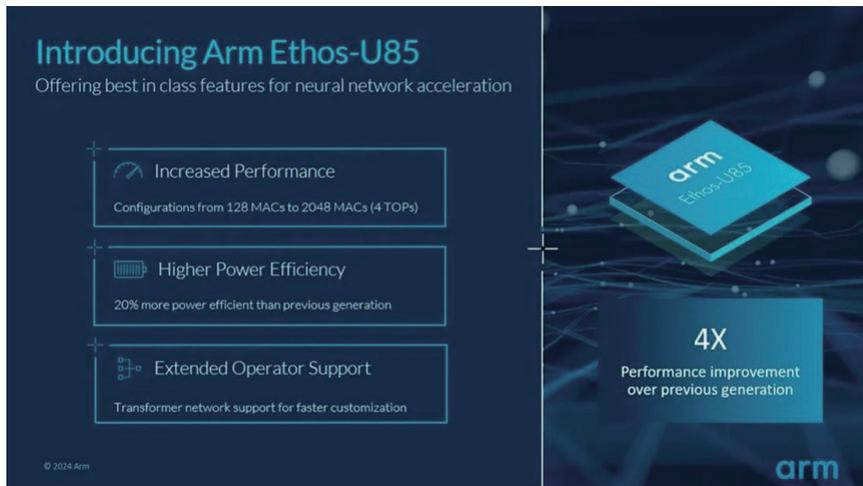


图2: Arm Ethos-U85 NPU 将提供在边缘侧和端侧设备上执行领先 AI 功能所需的算力。

其中包括领先的芯片合作伙伴,以及在 Arm 计算平台上构建应用的 2,000 多万软件开发等等。

这一切始于 Armv7 架构,该架构引入了高级单指令多数据 (SIMD) 扩展,例如 Neon 技术,这是 Arm 首次涉足机器学习 (ML) 工作负载。在过去几年中,该架构不断增强,Armv8 中增加了向量点积和矩阵乘法特性,之后在 Armv9 中又引入了 Arm SVE2 和新的 Arm SME 技术,为广泛的生成式 AI 工作负载和用例提高了计算性能并降低了功耗。

Blackwell GPU 架构与基于 Arm Neoverse 的 Grace CPU 相结合。Arm 独特的产品组合使 NVIDIA 能够进行系统级设计优化,与 NVIDIA H100 GPU 相比,其能耗降低了 25 倍,单个 GPU 性能提高了 30 倍。具体来说,得益于 Arm Neoverse 平台的灵活性,NVIDIA 能够实现自有的高带宽 NVLink 互连技术,并提升 CPU、GPU 和内存之间的数据带宽和延迟。

Arm 致力于通过 Arm 全面设计生态项目,为整个生态系统注入 AI 加速的机遇。通过该生态项目,开发者可以更快访问 Arm CSS 技术,赋能软硬件技术进步,以此驱动 AI 和芯片创新,并加快开发和部署 AI 优化的芯片解决方案。

### Arm 架构满足 AI 所需的独特灵活性

Arm CPU 设计所具有灵活性关键在于 Arm 领先的架构。它提供了一个可以与 AI 加速器技术紧密集成的基础平台,并支持从 128 位到 2,048 位的各种向量长度,可以在许多不同的数据点上轻松执行多个神经网络。

Arm 架构的灵活性为整个芯片生态系统提供了多样化的定制机会,Arm 一直致力于帮助合作伙伴更快地构建自己的差异化芯片解决方案。这种独特的灵活性也使 Arm 能够不断进行架构创新,定期推出关键指令和功能来加速 AI 计算,进而惠及整个生态系统,

### 与 AI 加速器技术无缝集成

Arm 是 AI 时代的计算平台,推动了持续的架构创新,以满足速度更快、互动性更好和沉浸感更强的 AI 应用的发展。Arm CPU 作为灵活处理 AI 工作负载的异构计算方法中的一部分,可以无缝增强和集成 GPU 和 NPU 等 AI 加速器技术。

Arm CPU 是处理众多 AI 推理工作负载的实用之选,凭借出色的灵活性,它能够与加速器技术无缝集成,打造更强大、更高性能的 AI 功能,精准满足特定用例和计算需求。对于 Arm 的技术合作伙伴而言,出色的灵活性有助于实现丰富的定制选择,使他们能够为 AI 工作负载构建完整的芯片解决方案。◆

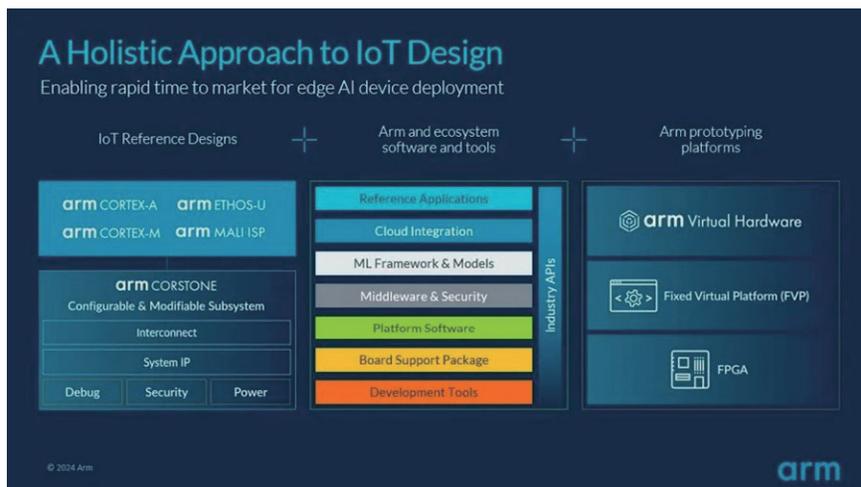


图3: 全新物联网参考设计平台 Corstone-320 结合了领先的 Arm 嵌入式 IP、软件、工具和支持,能加快语音、音频和视觉系统的部署。

# 慕尼黑上海光博会

## LASER World of PHOTONICS CHINA

20  
YEARS OF LASER CHINA

2025年3月11日至13日

📍 上海新国际博览中心-3号入口厅

慕尼黑上海光博会 🔍



扫码即刻注册参观

20周年盛典 敬，追光的你！

激光器与  
光电子

激光智能  
制造

检测与  
质量控制

光学元器件  
及材料

生物医学  
光子学

光学制造

集成  
光子学

红外技术  
与应用

Advertiser	广告商名称	网址	页码
ACM	盛美上海	www.acmrcsh.com.cn	1
东莞市晟鼎精密仪器有限公司		www.sindin.com	3
SEMICON China 2025		www.semiconchina.org	IBC
2025 慕尼黑上海光博会		www.world-of-photonics-china.com.cn	39

## 欢迎投稿

《半导体芯科技》(Silicon Semiconductor China, SiSC) 是面向中国半导体行业的专业媒体, 已获得全球知名权威杂志《Silicon Semiconductor》的独家授权。本刊针对中国半导体市场特点遴选相关优秀文章翻译, 并汇集编辑征稿、采编国内外半导体行业新闻、深度分析和权威评论等多方面内容。本刊由香港雅时国际通讯 (ACT International) 以简体中文出版发行。

本刊内容覆盖半导体制造工艺技术、封装、设备、材料、测试、MEMS、mini/Micro-LED 等。文章重点关注以下内容:

### FAB (Foundry, IDM, OSAT, R&D)

四个环节: 晶圆制造 (wafer 后道)、芯片制造、先进封装、洁净室; 深入报道与之相关的制造工艺、材料分析, 工艺材料、工艺设备、测试设备、辅助设备、系统工程、关键零部件, 以及与 particle (颗粒度) 及 contamination (沾污) 控制等厂务知识。

### FABLESS

芯片设计方案、设计工具, 以及与掩膜版内容和导入相关的资讯。

### 半导体基础材料及其应用

III-V 族、II-VI 族等先进半导体材料的科学研究成果、以及未来热门应用。《半导体芯科技》欢迎读者、供应商以及相关科研单位投稿, 已甄选中文稿件将在印刷版杂志以及网上杂志刊登; IC 设计及应用等半导体相关内容将酌情予以网络发表 (微信推送、杂志网站)。本刊优先刊登中文来稿 (翻译稿请附上英文原稿)。

## 技术文章要求

1. 论点突出、论据充分: 围绕主题展开话题, 如工艺提升、技术改造、系统导入、新品应用, 等等。
2. 结构严谨、短小精悍: 从发现问题到解决问题、经验总结, 一目了然, 字数以 3000 字左右为宜。
3. 文章最好配有 2-4 幅与内容有关的插图或图表。插图、图表按图 1、图 2、表 1、表 2 等依次排序, 编号与文中的图表编号一致。
4. 请注明作者姓名、职务及所在公司或机构名称。作者人数以四人为限。
5. 文章版权归著作者, 请勿一稿多投。稿件一经发表如需转载需经本刊同意。
6. 请随稿件注明联系方式 (电话、电子邮件)。

## 新产品要求

1. 新产品必须是在中国市场新上市、可在中国销售的。
2. 新产品稿件的内容应包含产品的名称、型号、功能、主要性能和特点、用途等。
3. 新产品投稿要求短小精悍, 中文字数 300~400 字左右。
4. 来稿请附产品照片, 照片分辨率不低于 300dpi, 最好是以单色作为背景。
5. 来稿请注明能提供进一步信息的人员姓名、电话、电子邮件。

电子邮箱: sunniez@actintl.com.hk  
viviz@actintl.com.hk

## 行政及销售 Administration & Sales Offices

### 行政人员 Administration

#### HK Office (香港办公室)

#### ACT International (雅时国际通讯)

Unit B, 13/F, Por Yen Building, No. 478 Castle Peak Road, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong  
Tel: 852 28386298

Publisher (社长) - China

Adonis Mak (麦协林), adonism@actintl.com.hk

Deputy Publisher (副社长) - China

Lisa Cheng (程丽娜), lisac@actintl.com.hk

General Manager-China (中国区总经理)

Floyd Chun (秦泽峰), floyd@actintl.com.hk

Editor in China (中国版编辑)

Sunnie Zhao (赵雪芹), sunniez@actintl.com.hk

Vivi Zhang (张雨薇), viviz@actintl.com.hk

#### London Office

Hannay House, 39 Clarendon Road  
Watford, Herts, WD17 1JA, UK.

T: +44 (0)1923 690200

#### Coventry Office

Unit 6, Bow Court, Fletchworth Gate  
Burnsall Road, Coventry, CV5 6SP, UK.

T: +44 (0)2476 718 970

Publisher & Editor-SiS English

Jackie Cannon, jackie.cannon@angelbc.com

+44 (0)1923 690205

### 销售人员 Sales Offices

#### China (中国)

#### Wuhan (武汉)

Lisa Cheng (程丽娜), lisac@actintl.com.hk

Tel: 86 185 7156 2977

Mini Xu (徐若男), minix@actintl.com.hk

Tel: 86 187 7196 7314

Phoebe Yin (尹菲菲), phoebey@actintl.com.hk

Tel: 86 155 2754 0817

Ron Wang (汪毓神), ronw@actintl.com.hk

Tel: 86 186 9404 8156

#### Shenzhen (深圳)

Yoyo Deng (邓丹), yoyod@actintl.com.hk

Tel: 86 135 3806 1660

#### Shanghai (上海)

Hatter Yao (姚丽莹), hattery@actintl.com.hk

Tel: 86 139 1771 3422

#### Beijing (北京)

Cecily Bian (边团芳), cecilyB@actintl.com.hk

Tel: 86 135 5262 1310

#### Hong Kong (香港特别行政区)

Floyd Chun (秦泽峰), floyd@actintl.com.hk

Tel: 852 2838 6298

#### Asia (亚洲)

#### Japan (日本)

Masaki Mori, masaki.mori@ex-press.jp

Tel: 81 3 6721 9890

#### Korea (韩国)

Lucky Kim, semieri@semieri.co.kr

Tel: 82 2 574 2466

#### Taiwan, Singapore, Malaysia

(台湾, 新加坡, 马来西亚)

Regional Sales Director

Floyd Chun (秦泽峰), floyd@actintl.com.hk

Tel: 852 2838 6298

#### US (美国)

Janice Jenkins, jjenkins@brunmedia.com

Tel: 724 929 3550

Tom Brun, tbrun@brunmedia.com

Tel: 724 539 2404

#### Europe (欧洲)

Shehzad Munshi, Shehzad.Munshi@angelbc.com

Tel: +44 (0)1923 690215

Jackie Cannon, Jackie.cannon@angelbc.com

Tel: +44 (0) 1923 690205



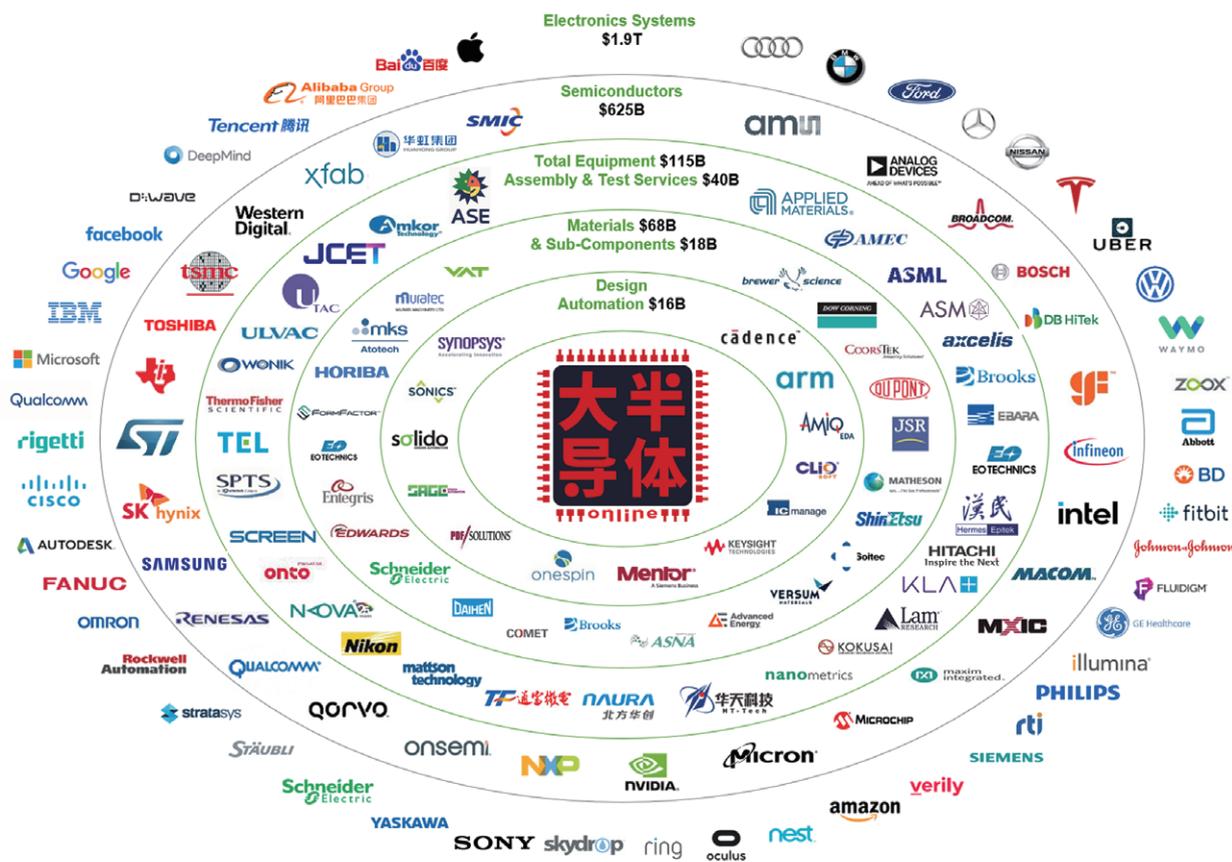
# SEMICON<sup>®</sup> CHINA

## FPDCHINA 跨界全球·心芯相联

2025年3月26-28日 | 上海新国际博览中心



# 全球最大的半导体行业盛会



**免费自助发产品**  
 7000+公司 | 26万+专业观众  
**货比三家选精品**



## ◆ 线下 ◆

### 化合物半导体 & 半导体芯科技 综合论坛

#### 05月·苏州 半导体先进技术创新发展和机遇大会

##### 平行论坛: Compound Semiconductor China

- 化合物半导体材料衬底、外延生长及其相关设备技术
- 超宽禁带器件:最终解决方案?
- 功率电子器件及封装和应用技术
- “AI+先进光显”引领未来
- 面向未来数据中心和6G网络下的射频器件研究进展
- 激光通信、精密加工及量测技术
- 先进半导体材料、器件的可靠性验证和故障分析

##### 平行论坛: CHIP China晶芯研讨会

- 玻璃通孔(TGV)技术创新发展和应用推动
- 面板级封装技术的崛起
- AI驱动的光电合封(CPO)新态势
- 车规级封测的挑战与解决方案
- 2.5D/3D/3.5D封装在AI趋势下大有可为
- 异构集成、芯粒(chiplet)、先进互连、混合键合、背面供电.....技术发展与应用

### Compound Semiconductor China

#### 7月·广州 化合物半导体先进技术及应用大会

- 化合物半导体材料衬底、外延生长及其相关设备技术
- 能源变革大时代,功率器件及应用市场格局
- 先进显示与照明取得的进展
- 先进半导体材料、器件的可靠性验证和故障分析
- 超快通信射频器件新应用

#### 10月·常州 化合物半导体先进技术及应用大会

- 化合物半导体材料衬底、外延生长及其相关设备技术
- 面向未来数据中心和6G网络下的射频器件研究进展
- 功率电子器件及封装和应用技术
- 扩大表面发射器的视野
- 激光通信、精密加工及量测技术

### CHIP China晶芯研讨会

#### 11月·厦门 第三届-半导体先进封测产业技术创新大会

- 玻璃通孔(TGV)技术创新发展和应用推动
- 面板级封装技术的崛起
- AI驱动的光电合封(CPO)新态势
- 车规级封测的挑战和解决方案
- 2.5D/3D/3.5D封装在AI趋势下大有可为
- 异质集成·先进封装关键材料与创新
- 2.5D/3D封装设计仿真与可靠性
- 先进封装对新型装备技术的需求和挑战
- 异构集成、芯粒(chiplet)、先进互连、混合键合、背面供电.....技术发展与应用

## ◆ 线上 ◆

### Compound Semiconductor China

### CHIP China晶芯研讨会

先进半导体材料的检测/量测关键技术 | GaN功率应用,厚积薄发

玻璃通孔(TGV)技术创新发展和应用推动 | 面板级封装技术的崛起

MicroLED取得的进展 | 超宽禁带材料、器件解决方案 | PIC的新应用

先进封装制造工艺与材料的创新 | 先进半导体键合集成技术

面向未来数据中心和6G网络下的射频器件研究进展

光电合封(CPO)及光电互连技术发展 | 2.5D/3D封装设计仿真与可靠性

## ◆ 定制专场论坛 ◆

重点依据企业需求定制化会议主题,线上直播与线下执行双向选择,垂直听众定向邀约,充分发挥资源链接优势,突破原有格局,助力泛半导体产业客户实现多元化探索路径。

线下会议



线上会议



推介目的性强 会议听众垂直  
议题内容聚焦 直击产品核心

\* 以上主题暂定,请以会议举办议题为准

